(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-114759 (P2001-114759A)

(43)公開日 平成13年4月24日(2001.4.24)

(51) Int.CL'

識別記号

FΙ C 0 7 D 207/16 テーマコート*(参考) 4C069

C 0 7 D 207/16

審査請求 未請求 請求項の数22 OL (全 32 頁)

(21)出顧番号

特顧2000-242254(P2000-242254)

(22)出顧日

平成12年8月10日(2000.8.10)

(31) 優先権主張番号 特願平11-228551

(32) 優先日

平成11年8月12日(1999.8.12)

(33) 優先権主張国

日本 (JP)

(71)出顧人 000001856

三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号

(72)発明者 川本 勲

東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株

式会社内

(72)発明者 下地 康雄

東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株

式会社内

(74)代理人 100081400

弁理士 大野 彰夫 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 メルカプトピロリジン誘導体

(57)【要約】

【課題】カルバペネム系抗菌剤の2位側鎖部分の製造中 間体として有用なメルカプトピロリジン化合物を提供す

【解決手段】一般式

【化1】

(式中、nは0、1または2を示し、Aは水酸基で置換 されていてもよい炭素数1乃至8個のアルキレン基を示 し、R1はアシル基を示し、R2は炭素数1乃至4個のア ルキル基を示し、R3は水素原子または炭素数1乃至4 個のアルキル基を示し、R⁴及びR⁵は同一又は異なって 水素原子またはイミノ基若しくはアミノ基の保護基を示 す。) で表わされるメルカプトピロリジン化合物または その塩。

【特許請求の範囲】 【請求項1】一般式

【化1】

(式中、nは0,1または2を示し、Aは水酸基で置換されていてもよい炭素数1乃至8個のアルキレン基を示 10 し、R¹はアシル基を示し、R²は炭素数1乃至4個のアルキル基を示し、R³は水素原子または炭素数1乃至4個のアルキル基を示し、R⁴及びR⁵は同一又は異なって水素原子またはイミノ基若しくはアミノ基の保護基を示す。)で表わされるメルカプトピロリジン化合物またはその塩、

【請求項2】請求項1において、nが0または1である 化合物またはその塩。

【請求項3】請求項1において、nが1である化合物またはその塩

【請求項4】請求項1乃至3いずれか1項において、A が炭素数1乃至3個のアルキレン基である化合物または その塩。

【請求項5】請求項1乃至3のいずれか1項において、 Aがメチレン、エチレンまたは1,1-エチレン基であ る化合物またはその塩。

【請求項6】請求項1乃至3のいずれか1項において、 Aがメチレン基である化合物またはその塩。

【請求項7】請求項1乃至6のいずれか1項において、R¹が炭素数2乃至4個のアルカノイル基または置換されていてもよいベンゾイル基(該置換基はメチル又は塩素原子である)である化合物またはその塩。

【請求項8】請求項1乃至6いずれか1項において、R 1がアセチルまたはベンゾイル基である化合物またはそ の塩。

【請求項9】請求項1乃至6いずれか1項において、R 1がアセチル基である化合物またはその塩。

【請求項10】請求項1乃至9いずれか1項において、 R²がメチル基である化合物またはその塩。

【請求項11】請求項1乃至10いずれか1項において、R3が水素原子またはメチル基である化合物または その塩。

【請求項12】請求項1乃至10いずれか1項において、のいずれかにおいて、R3が水素原子である化合物またはその塩。

【請求項13】請求項1乃至12いずれか1項において、R4が水素原子又はイミノ基の保護基である化合物またはその塩。

【請求項14】請求項1乃至12いずれか1項において、R4が水素原子、4-ニトロベンジルオキシカルボ

ニル、t-ブトキシカルボニルまたはアリルオキシカルボニル基である化合物またはその塩。

【請求項15】請求項1乃至12いずれか1項において、R4が水素原子または4-ニトロベンジルオキシカルボニル基である化合物またはその塩。

【請求項16】請求項1乃至15いずれか1項において、R5がアミノ基の保護基である化合物またはその塩。

【請求項17】請求項1乃至15いずれか1項において、R5が4-ニトロベンジルオキシカルボニル、t-ブトキシカルボニルまたはアリルオキシカルボニル基である化合物またはその塩。

【請求項18】請求項1乃至15いずれか1項において、R5が4-ニトロベンジルオキシカルボニル基である化合物またはその塩。

【請求項19】請求項1において、nが0または1であり、Aが炭素数1乃至3個のアルキレン基であり、R¹が炭素数2乃至4個のアルカノイル基または置換されていてもよいベンゾイル基(該置換基はメチル又は塩素原20 子である)であり、R²が炭素数1乃至4個のアルキル基であり、R³が水素原子又は炭素数1乃至4個のアルキル基であり、R⁴が水素原子又はイミノ基の保護基であり、R⁵がアミノ基の保護基である化合物またはその塩。

【請求項20】請求項1において、nが0または1であり、Aがメチレン、エチレンまたは1,1-エチレン基であり、R¹がアセチル、プロピオニルまたはベンゾイル基であり、R²がメチル基であり、R³が水素原子又はメチル基であり、R⁴が水素原子、4-ニトロベンジルオキシカルボニル、t-ブトキシカルボニルまたはアリルオキシカルボニル、t-ブトキシカルボニルまたはアリルオキシカルボニル、t-ブトキシカルボニルまたはアリルオキシカルボニル、t-ブトキシカルボニルまたはアリルオキシカルボニルとである化合物またはその塩。

【請求項21】請求項1において、nが0または1であり、Aがメチレン、エチレンまたは1,1-エチレン基であり、R¹がアセチルまたはベンゾイル基であり、R²がメチル基であり、R³が水素原子またはメチル基であり、R⁴が水素原子または4-ニトロベンジルオキシカルボニル基であり、R⁵が4-ニトロベンジルオキシカルボニル基である化合物またはその塩。

【請求項22】請求項1において、nが1であり、Aがメチレン基であり、R¹がアセチル基であり、R²がメチル基であり、R³が水素原子であり、R⁴が水素原子または4ーニトロベンジルオキシカルボニル基であり、R⁵が4ーニトロベンジルオキシカルボニル基である化合物またはその塩。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は優れた抗菌活性を有50 するカルバペネム系抗菌剤の2位側鎖を構築するための

有用な原料であるメルカプトピロリジン化合物に関す る。

[0002]

【従来の技術】特開平10-204086号公報におい て、優れた抗菌活性を有するカルバペネム化合物および その2位側鎖の原料となる4-(4-メトキシベンジル チオ) ピロリジン誘導体が開示されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、メルカプト基 の保護基である4-メトキシベンジル基は、必ずしも温 10 和な条件下で効率よく除去できるわけではなく、カルバ ベネム系抗菌剤の製造において好ましい中間体とはいえ ない。

【0004】本発明者等は、メルカプト基の保護基とし てアシル基を有するピロリジン化合物がカルバペネム系 抗菌剤の製造中間体として極めて有用であることを見出 し本発明を完成した。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は下記の化合物及 びその塩である。

(1) 一般式

[0006]

【化2】

(式中、nはO, 1または2を示し、Aは水酸基で置換 されていてもよい炭素数1乃至8個のアルキレン基を示 30 物またはその塩。 し、R1はアシル基を示し、R2は炭素数1乃至4個のア ルキル基を示し、R3は水素原子または炭素数1乃至4 個のアルキル基を示し、R4及びR5は同一又は異なって 水素原子またはイミノ基若しくはアミノ基の保護基を示 す。) で表わされるメルカプトピロリジン化合物または その塩。

- (2) (1)において、nが0または1である化合物 またはその塩。
- (3) (1)において、nが1である化合物またはそ の塩。
- (4) (1) 乃至(3) のいずれかにおいて、Aが炭 素数1乃至3個のアルキレン基である化合物またはその 塩。
- (5) (1) 乃至(3) のいずれかにおいて、Aがメ チレン、エチレンまたは1、1-エチレン基である化合 物またはその塩。
- (6) (1) 乃至(3) のいずれかにおいて、Aがメ チレン基である化合物またはその塩。
- (7) (1)乃至(6)のいずれかにおいて、R¹が

てもよいベンゾイル基 (該置換基はメチル又は塩素原子 である)である化合物またはその塩。

- (8) (1) 乃至(6) のいずれかにおいて、R1が アセチルまたはベンゾイル基である化合物またはその
- (9) (1) 乃至(6) のいずれかにおいて、R1が アセチル基である化合物またはその塩。
- (10) (1) 乃至(9) のいずれかにおいて、R2 がメチル基である化合物またはその塩。
- (11) (1)乃至(10)のいずれかにおいて、R 3が水素原子またはメチル基である化合物またはその
- (12)(1)乃至(10)のいずれかにおいて、R 3が水素原子である化合物またはその塩。
- (1) 乃至 (12) のいずれかにおいて、R (13) 4が水素原子又はイミノ基の保護基である化合物または その塩。
- (14) (1) 乃至(12) のいずれかにおいて、R 4が水素原子、4-二トロベンジルオキシカルボニル、t 20 -ブトキシカルボニルまたはアリルオキシカルボニル基 である化合物またはその塩。
 - (15) (1)乃至(12)のいずれかにおいて、R 4が水素原子または4-ニトロベンジルオキシカルボニ ル基である化合物またはその塩。
 - (16) (1) 乃至(15) のいずれかにおいて、R 5がアミノ基の保護基である化合物またはその塩。
 - (17) (1) 乃至(15) のいずれかにおいて、R 5が4-ニトロベンジルオキシカルボニル、t-ブトキシ カルボニルまたはアリルオキシカルボニル基である化合
 - (18) (1) 乃至(15) のいずれかにおいて、R 5が4-二トロベンジルオキシカルボニル基である化合 物またはその塩。上記の一般式(1)で表わされる化合 物において、nは好適にはOまたは1であり、最も好適 には1である。

【0007】Aの「水酸基で置換されていてもよい炭素 数1乃至8個のアルキレン基」における「炭素数1乃至 8個のアルキレン基」は、炭素数1乃至8個の直鎖又は 分枝状のアルキレン基であり、例えばメチレン、エチレ 40 ン、1, 1 −エチレン [−CH (CH₃) −]、トリメ チレン、1,1ートリメチレン、1,2ートリメチレ ン、テトラメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメチレン 基等を挙げることができる。

【0008】上記の「炭素数1乃至8個のアルキレン 基」は、水酸基で置換されていてもよく、例えば2-ヒ ドロキシトリメチレン、2-ヒドロキシテトラメチレ ン、3-ヒドロキシテトラメチレン基等を挙げることが できる。

【0009】Aの「水酸基で置換されていてもよい炭素 炭素数2乃至4個のアルカノイル基または置換されてい 50 数1乃至8個のアルキレン基」全体として、好適には炭 素数1乃至3個の直鎖又は分枝状のアルキレン基であり、更に好適にはメチレン、エチレン、1,1-エチレンまたはトリメチレン基であり、更に好適にはメチレン、エチレン、1,1-エチレン基であり、最も好適にはメチレン基である。

【0010】R¹の「アシル基」としては、例えばアセチル、プロピオニル、ブチリル基のような炭素数2乃至4個のアルカノイル基またはベンゾイル、トルオイル、クロロベンゾイル、ナフトイル基のような置換されていてもよい炭素数6乃至10個のアリールーカルボニル基(該置換基はメチル、エチル、プロピルのような炭素数1乃至3個のアルキル基またはフッ素、塩素、臭素のようなハロゲン原子である)を挙げることができ、好適には炭素数2乃至4個のアルカノイル基または置換されていてもよいベンゾイル基(該置換基はメチル又は塩素原子である)であり、更に好適にはアセチル、プロピオニルまたはベンゾイル基であり、より更に好適にはアセチルまたはベンゾイル基であり、最も好適にはアセチルまたはベンゾイル基であり、最も好適にはアセチルをである。

【0011】R²の「炭素数1乃至4個のアルキル基」としては、例えばメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sec-ブチル及びt-ブチル基を挙げることができ、好適にはメチル又はエチル基であり、最も好適にはメチル基である。

【0012】R3の「炭素数1乃至4個のアルキル基」は、R2におけるのと同意義である。

【0013】R³全体としては、好適には水素原子又は メチル基であり、最も好適には水素原子である。

【0014】R4及びR5の「イミノ基若しくはアミノ基 の保護基」としては、例えばベンジルオキシカルボニ ル、4-ニトロペンジルオキシカルボニル、4-メトキ シベンジルオキシカルボニル、4-クロロベンジルオキ シカルボニル、トリメチルベンジルオキシカルボニルの ような置換されていてもよい炭素数6乃至10個のアリ ールーメチルオキシカルボニル基 (該置換基はニトロ 基、メチル、エチル、プロピルのような炭素数1乃至3 個のアルキル基、メトキシ、エトキシ、プロポキシのよ うな炭素数1乃至3個のアルコキシ基、フッ素、塩素の ようなハロゲン原子である);メトキシカルボニル、エ トキシカルボニル、t-ブトキシカルボニル、2,2,2 ートリクロロエトキシカルボニルのような置換されてい てもよい炭素数1乃至4個のアルキルーオキシカルボニ ル基(該置換基はフッ素、塩素のようなハロゲン原子で ある); アリルオキシカルボニル、2-クロロアリルオ キシカルボニル、ビニルオキシカルボニルのような置換 されていてもよい炭素数2乃至4個のアルケニルーオキ シカルボニル基(該置換基はフッ素、塩素のようなハロ ゲン原子である)を挙げることができ、好適には4-二 トロベンジルオキシカルボニル、t-ブトキシカルボニル。 4-二トロベンジルオキシカルボニル基である。

【0015】R4全体としては、好適には水素原子又はイミノ基の保護基であり、更に好適には水素原子、4ーニトロベンジルオキシカルボニル、セブトキシカルボニルまたはアリルオキシカルボニル基であり、より更に好適には水素原子または4ーニトロベンジルオキシカルボニル基である。

【0017】本発明の一般式(1)を有する化合物またはその塩において、n、A、R¹、R²、R³、R⁴及びR⁵について好適なものを適宜組み合わせて得られる化合物またはその塩は更に好適であり、例えば下記の(19)乃至(22)の化合物またはその塩を挙げることができる。

(19) (1)において、nが0または1であり、A
が炭素数1乃至3個のアルキレン基であり、R¹が炭素
数2乃至4個のアルカノイル基または置換されていても
よいベンゾイル基(該置換基はメチル又は塩素原子であ
る)であり、R²が炭素数1乃至4個のアルキル基であ
り、R³が水素原子又は炭素数1乃至4個のアルキル基
であり、R⁴が水素原子又はイミノ基の保護基であり、
R⁵がアミノ基の保護基である化合物またはその塩。

(20) (1)において、nが0または1であり、Aがメチレン、エチレンまたは1,1-エチレン基であり、R¹がアセチル、プロピオニルまたはベンゾイル基30であり、R²がメチル基であり、R³が水素原子又はメチル基であり、R⁴が水素原子、4-ニトロベンジルオキシカルボニル、t-ブトキシカルボニルまたはアリルオキシカルボニル基であり、R⁵が4-ニトロベンジルオキシカルボニル、t-ブトキシカルボニルまたはアリルオキシカルボニル、t-ブトキシカルボニルまたはアリルオキシカルボニル基である化合物またはその塩。

(21) (1) において、nが0または1であり、Aがメチレン、エチレンまたは1,1-エチレン基であり、R¹がアセチルまたはベンゾイル基であり、R²がメチル基であり、R³が水素原子またはメチル基であり、R⁴が水素原子または4-ニトロベンジルオキシカルボニル基であり、R⁵が4-ニトロベンジルオキシカルボニル基である化合物またはその塩。

(22) (1) において、nが1であり、Aがメチレン基であり、R¹がアセチル基であり、R²がメチル基であり、R³が水素原子であり、R⁴が水素原子または4-ニトロベンジルオキシカルボニル基であり、R⁵が4-ニトロベンジルオキシカルボニル基である化合物またはその塩。

トロベンジルオキシカルボニル、t-ブトキシカルボニル 【0018】本発明の一般式(1)で表わされるメルカまたはアリルオキシカルボニル基であり、最も好適には 50 プトピロリジン化合物には、2位及び4位の不斉炭素に

基づく立体異性体が存在するが、それらの異性体は通常 用いられている立体選択的合成方法、不斉合成法、光学 分割法等により製造または分離することが可能であり、 本発明はそれらの立体異性体及びそれらの任意の割合の 混合物を包含する。カルバペネム系抗菌剤の製造中間体 として好適なものは、2位及び4位の配置が(2S,4 S) の組み合わせの化合物である。

【0019】本発明の一般式(1)で表わされるメルカ プトピロリジン化合物は塩基性の窒素原子を有するの で、酸性化合物と結合して塩を形成することができる。 そのような塩としては、塩酸、硫酸、硝酸のような無機 酸類との塩;炭酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、シュウ 酸、フタル酸のような有機カルボン酸類との塩;メタン スルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、ベンゼン スルホン酸、トルエンスルホン酸のような有機スルホン 酸類との塩等を挙げることができ、好適には塩酸塩また は硫酸塩である。

【0020】また、本発明の化合物(1)は、大気中に 放置しておくことにより、水分を吸収し、吸着水が付い に包含される。更に、本発明の化合物(1)は、他のあ る種の溶媒を吸収し、溶媒和物となる場合があるが、そ のような塩も本発明に包含される。

【0021】本発明の一般式(1)で表わされるメルカ プトピロリジン誘導体として、好適な化合物を具体的に 例示する。なお、本発明の化合物(1)はこれらの化合 物に限定されない。

1. (2S, 4S) -4-アセチルチオ-2-[(3 S) -3-[2-[2, 3-ビス(4-ニトロベンジル オキシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロ 30 アゼチジン-1-イルカルボニル] ピロリジン リジン-1-イルカルボニル]-1-メチルピロリジン 2. (2S, 4S) -4-アセチルチオ-1-メチル -2-[(3S)-3-[2-[3-(4-ニトロベン ジルオキシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロリジン-1-イルカルボニル] ピロリジン

3. (2S, 4S) -4-ベンゾイルチオ-2-[(3S)-3-[2-[2, 3-ビス(4-ニトロベ ンジルオキシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミ ノ] ピロリジン-1-イルカルボニル] -1-メチルピ ロリジン

4. (2S, 4S) - 4 - (2Y/1) + 1 - 1 - X + 1 - X + 1ルー2ー[(35)-3-[2-[3-(4-ニトロベ ンジルオキシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミ ノ] ピロリジンー1ーイルカルボニル] ピロリジン

5. (2S, 4S) -4-アセチルチオー1-メチル

-2-[(3S)-3-[2-[1-x+n-2, 3-ビス (4-ニトロベンジルオキシカルボニル) グアニジ ノ] アセチルアミノ] ピロリジン-1-イルカルボニ ル] ピロリジン

6. (2S, 4S) -4-アセチルチオ-2-[(3 S) -3-[(2R) -2-[2, 3-ビス(4-ニト ロベンジルオキシカルボニル) グアニジノ] プロピオニ ルアミノ] ピロリジン-1-イルカルボニル] -1-メ チルピロリジン

10 7. (25, 45) -4-アセチルチオ-2-[(3 S) -3-[(2S) -2-[2, 3-ビス(4-ニト ロベンジルオキシカルボニル) グアニジノ] プロピオニ ルアミノ] ピロリジンー1ーイルカルボニル] ー1ーメ チルピロリジン

8. (2S, 4S) -4-アセチルチオ-2-[(3 R) -3-[2-[2, 3-ビス(4-ニトロベンジル オキシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロ リジン-1-イルカルボニル]-1-メチルピロリジン たり、水和物となる場合があり、そのような塩も本発明 20 -2-[(3R)-3-[2-[3-(4-ニトロベン ジルオキシカルボニル)グアニジノ]アセチルアミノ] ピロリジン-1-イルカルボニル] ピロリジン

> 10. (2S, 4S) -4-アセチルチオ-1-メチ ルー2-[(3S)-3-[3-[3-(4-ニトロベ ンジルオキシカルボニル) グアニジノ] プロピオニルア ミノ] ピロリジン-1-イルカルボニル] ピロリジン (25, 45) -4-アセチルチオ-1-メチ ルー2-[3-[2-[2, 3-ピス(4-ニトロベン ジルオキシカルボニル)グアニジノ]アセチルアミノ]

> ルー2-[3-[2-[2, 3-ピス(4-ニトロベン ジルオキシカルボニル)グアニジノ]アセチルアミノ] ピペリジン-1-イルカルボニル] ピロリジン

[0022]

【発明の実施の形態】本発明の一般式(1)で表わされ る化合物は、以下に示すA法またはB法によって製造す ることができる。

【0023】 [A法] A法は、一般式(2)で表わされ 40 るカルボン酸化合物と一般式(3)で表わされるアミノ 化合物を反応させて目的化合物(1)を製造する方法で ある。

[0024]

【化3】

[A法]

上記式中、n、A、R1、R2、R3、R4及びR5は前述 と同意義である。

【0025】第A1工程は、化合物(2)に溶媒中、塩 基の存在下、酸ハライドを反応させ、次いで化合物 (3)を反応させることにより達成される。

【0026】化合物(2)は、文献公知の方法(特開平 8-048667号公報) に準じて容易に製造すること ができる。化合物(3)は、後述するC法によって製造 することができる。

【0027】使用される酸ハライドとしては、例えばク ロロ炭酸エチル、クロロ炭酸イソプロピル、クロロ炭酸 イソブチルのようなハロゲン化炭酸アルキル; ピバロイ ルクロリドのようなα炭素に分枝を有するアルカノイル ハライドを挙げることができるが、好適にはピバロイル クロリドである。

【0028】酸ハライドの使用量は、化合物(2)に対 して通常0.8乃至2モル当量であり、好適には0.9 乃至1.2当量である。

【0029】使用される塩基としては、化合物の他の部 分に影響を与えないものであれば特に制限はないが、例 えばジイソプロピルエチルアミン、トリエチルアミンの ようなトリアルキルアミン類 ; N-メチルピペリジン、 N-メチルモルホリンのような飽和環状アミン類; ピリ ジン、4-ジメチルアミノピリジンのような芳香族アミ ン類:炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリ ウムのようなアルカリ金属炭酸塩;水酸化カリウム、水 酸化ナトリウムのようなアルカリ金属水酸化物を挙げる ことができ、好適にはトリアルキルアミン類(特にジイ ソプロピルエチルアミン) である。

【0030】塩基の使用量は、化合物(2)に対して通 常0.8乃至2モル当量であり、好適には0.9乃至 1.2当量である。

【0031】使用される溶媒としては、反応を阻害せず 出発原料をある程度溶解するものであれば特に制限はな く、例えばアセトニトリルのようなニトリル類;酢酸エ*50 ミダゾールを反応させ、次いで、化合物(3)を反応さ

*チルのようなエステル類;アセトン、メチルエチルケト ンのようなケトン類; ジクロロメタン、ジクロロエタ ン、クロロホルムのようなハロゲン化炭化水素類;エー テル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテ 20 ル類; ジメチルスルホキシドのようなスルホキシド類; ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドのような アミド類およびそれらの混合溶媒を挙げることができる が、好適にはニトリル類 (特にアセトニトリル)、エス テル類 (特に酢酸エチル)、エーテル類 (特にテトラヒ ドロフラン) またはハロゲン化炭化水素類 (特にジクロ ロメタン) であり、特に好適にはアセトニトリルであ る。

【0032】化合物(2)に酸ハライドを反応させると きの反応温度は、通常-40℃乃至室温であり、好適に 30 は-20℃乃至10℃である。反応時間は、原料、溶 媒、反応温度等によって異なるが、通常5分乃至24時 間であり、好適には30分乃至6時間である。

【0033】次いで、化合物(3)を反応させるときの 反応温度は、副反応をおさえるため比較的低温で行なう のが好ましく、通常-40℃乃至40℃であり、好適に は-20℃乃至0℃である。反応時間は、原料、溶媒、 反応温度等によって異なるが、通常15分乃至75時間 であり、好適には1時間乃至24時間である。

【0034】また、第A1工程は、化合物(2)に溶媒 中、N,N'ーカルボニルジイミダゾールを反応させ、 次いで化合物(3)を反応させることによっても達成さ na.

【0035】N、N'-カルボニルジイミダゾールの使 用量は、化合物(2)に対して通常0.8乃至2モル当 量であり、好適には0.9乃至1.2当量である。

【0036】使用される溶媒は、酸ハライドを用いた反 応におけるのと同様の溶媒を使用することができ、好適 にはアセトニトリルである。

【0037】化合物(2)にN, N'ーカルボニルジイ

せるときの反応温度は、副反応をおさえるため比較的低 温で行なうのが好ましく、通常-40℃乃至40℃であ り、好適には-20℃乃至0℃である。反応時間は、原 料、溶媒、反応温度等によって異なるが、通常15分乃 至75時間であり、好適には1時間乃至24時間であ る。

【0038】更に、第A1工程は、化合物(2)に溶媒 中、縮合剤の存在下に化合物(3)を反応させることに よっても達成される。

ルカルポジイミド、1-エチル-3-(3-ジメチルア ミノプロピル) カルボジイミド塩酸塩のようなカルボジ イミド類; ジエチルホスホリルシアニド、ジフェニルホ スホリルアジド、シアノ燐酸ジエチルのような燐酸エス テル類等を挙げることができ、カルボジイミド類を用い る場合、1-ヒドロキシベンゾトリアゾールを併用して もよい。これらの縮合剤のうち好適には、1、3-ジシ クロヘキシルカルボジイミド、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピル) カルボジイミド塩酸塩または ジエチルホスホリルシアニドである。

【0040】縮合剤の使用量は、化合物(2)に対して 通常0.8乃至2モル当量であり、好適には0.9乃至 1.2当量である。

【0041】使用される溶媒は、酸ハライドを用いた反

12

応におけるのと同様の溶媒を使用することができ、好適 にはアセトニトリルである。

【0042】反応温度は、副反応をおさえるため比較的 低温で行なうのが好ましく、通常-40℃乃至40℃で あり、好適には-20℃乃至0℃である。反応時間は、 原料、溶媒、反応温度等によって異なるが、通常15分 乃至75時間であり、好適には1時間乃至24時間であ る。

【0043】反応終了後、本反応の目的化合物は常法に 【0039】縮合剤としては、1,3-ジシクロヘキシ 10 従って反応混合物から採取することができる。例えば、 反応混合液から溶媒を留去して得られる残渣に水と混和 しない有機溶剤を加え、水洗後、溶剤を留去することに よって得られる。得られた化合物は必要ならば常法、例 えば再結晶、再沈殿またはクロマトグラフィーなどによ って更に精製することができる。

> 【0044】 [B法] B法は、窒素原子が保護された4 -ヒドロキシプロリン(4)にアミノ化合物(3)を反 応させ、スルホニル化剤を反応させて水酸基をスルホニ ル化し、アシルチオ化剤を反応させてアシルチオ基を導 20 入し、次いで窒素原子上の保護基を除去し、最後にアル キル化剤と反応させることによって化合物(1)を製造 する方法である。

[0045]

【化4】

上記式中、n、A、R¹、R²、R³、R⁴及びR⁵は前述と同意義である。R⁶は、アミノ基の保護基を示し、前記のR⁴またはR⁵における保護基のほか、ベンジル、ベンツヒドリル、トリチルのような1乃至3個のフェニル基で置換されたメチル基を挙げることができる。R⁷はメチル、エチル、プロピル、トリフルオロメチルのようなフッ素原子で置換されていてもよい炭素数1乃至4個のアルキル基またはフェニル、ナフチル、トリルのような炭素数1乃至3個のアルキルで置換されていてもよい炭素数6乃至10個のアリール基を示す。X¹はハロゲン原子のような脱離基を示す。

【0046】第B1工程は、カルボン酸化合物(4)と アミノ化合物(3)を反応させて化合物(5)を製造す る工程である。本工程は、前述の第A1工程と同様にし て達成することができる。

- *【0047】第B2工程は、化合物(5)の水酸基をスルホニル化して化合物(6)を製造する工程である。本工程は化合物(5)に溶媒中、塩基の存在下にスルホニル化剤を反応させることによって達成される。
- 40 【0048】スルホニル化剤としては、式R7SO2X¹(式中、R7及びX¹は前述の通りである)で表わされる化合物(6)または相当するスルホン酸無水物を使用することができ、例えばメタンスルホニルクロリド、エタンスルホニルクロリド、トリフルオロメタンスルホン酸無水物、ベンゼンスルホニルクロリド、pートルエンスルホニルクロリドを挙げることができ、好適にはpートルエンスルホニルクロリドである。

【0049】スルホニル化剤の使用量は、化合物(5) に対して通常0.8乃至2モル当量であり、好適には *50 0.9乃至1.2当量である。 【0050】使用される塩基としては、化合物の他の部分に影響を与えないものであれば特に制限はないが、例えばジイソプロピルエチルアミン、トリエチルアミンのようなトリアルキルアミン類; N-メチルピペリジン、N-メチルモルホリンのような飽和環状アミン類; ピリジン、4-ジメチルアミノピリジンのような芳香族アミン類; 炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウムのようなアルカリ金属炭酸塩; 水酸化カリウム、水酸化ナトリウムのようなアルカリ金属水酸化物を挙げることができ、好適にはトリアルキルアミン類(特にジイソプロピルエチルアミン)である。

【0051】塩基の使用量は、化合物(5)に対して通常0.8乃至2モル当量であり、好適には0.9乃至1.2当量である。

【0052】使用される溶媒としては、反応を阻害せず出発原料をある程度溶解するものであれば特に制限はなく、例えばアセトニトリルのようなニトリル類;酢酸エチルのようなエステル類;アセトン、メチルエチルケトンのようなケトン類;ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルムのようなハロゲン化炭化水素類;エーでル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテル類;ジメチルスルホキシドのようなスルホキシド類;ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドのようなアミド類およびそれらの混合溶媒を挙げることができるが、好適にはニトリル類(特にアセトニトリル)、エステル類(特に酢酸エチル)、エーテル類(特にテトラヒドロフラン)またはハロゲン化炭化水素類(特にジクロロメタン)であり、特に好適にはアセトニトリルである。

【0053】反応温度は、通常-20乃至40℃であり、好適には-10℃乃至20℃である。反応時間は、原料、溶媒、反応温度等によって異なるが、通常15分乃至75時間であり、好適には1乃至24時間である。【0054】反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って反応混合物から採取することができる。例えば、反応混合液から溶媒を留去して得られる残渣に水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、溶剤を留去することによって得られる。得られた化合物は必要ならば常法、例えば再結晶、再沈殿またはクロマトグラフィーなどによって更に精製することができる。

【0055】また、化合物(4)に溶媒中、第B2工程で使用される塩基及びスルホニル化試薬を2乃至4当量加え、次いで化合物(3)を反応させることによっても化合物(7)を製造することができる。

【0056】第B3工程は、化合物(7)にアシルチオ基を導入して化合物(9)を製造する工程である。本工程は化合物(7)に溶媒中、塩基の存在下または非存在下にアシルメルカプタン(8)またはその金属塩を反応させることによって達成される。

【0057】 アシルメルカプタン (8) は、式R¹SH

16 iり所望のアシル基を示す)て

(式中、R¹は前述の通り所望のアシル基を示す)で表 わされる化合物であり、好適にはチオ酢酸、チオプロピ オン酸、チオ安息香酸である。

【0058】その金属塩としては、例えばリチウム、ナトリウム、カリウム、セシウムのようなアルカリ金属塩;マグネシウム、カルシウムのようなアルカリ土類金属塩;銅、銀、亜鉛のような遷移金属塩を挙げることができ、好適にはアルカリ金属塩であり、更に好適にはナトリウム、カリウム又はセシウム塩である。アシルメル10カプタン金属塩としては、チオ酢酸ナトリウム、チオ酢酸カリウム、チオ酢酸セシウム、チオ安息香酸ナトリウム、チオ安息香酸カリウム、チオ酢酸カリウムまたはチオ酢酸セシウムである。

【0059】アシルメルカプタンまたはその金属塩の使用量は、化合物(7)に対して通常0.8乃至2モル当量であり、好適には0.9乃至1.2当量である。

【0060】アシルメルカプタンを使用する場合、好ましくは塩基の存在下で反応させる。使用される塩基としては、化合物の他の部分に影響を与えないものであれば特に制限はないが、例えばジイソプロピルエチルアミン、トリエチルアミンのようなトリアルキルアミン類; Nーメチルピペリジン、Nーメチルモルホリンのような飽和環状アミン類; ピリジン、4ージメチルアミノピリジンのような芳香族アミン類; 炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウムのようなアルカリ金属炭酸塩; 水酸化カリウム、水酸化ナトリウムのようなアルカリ金属炭酸塩類 (特に炭酸カリウム) である。

30 【0061】塩基の使用量は、化合物(5)に対して通常0.8乃至2モル当量であり、好適には0.9乃至1.2当量である。

【0062】使用される溶媒としては、反応を阻害せず 出発原料をある程度溶解するものであれば特に制限はな く、例えばアセトニトリルのようなニトリル類;酢酸エ チルのようなエステル類 ; アセトン、メチルエチルケト ンのようなケトン類; ジクロロメタン、ジクロロエタ ン、クロロホルムのようなハロゲン化炭化水素類;エー テル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテ 40 ル類;ジメチルスルホキシドのようなスルホキシド類; ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドのような アミド類:メタノール、エタノールのようなアルコール 類:水およびそれらの混合溶媒を挙げることができる が、好適にはニトリル類(特にアセトニトリル)、エス テル類(特に酢酸エチル)、エーテル類(特にテトラヒ ドロフラン) またはハロゲン化炭化水素類 (特にジクロ ロメタン) であり、特に好適にはアセトニトリルであ る。

【0063】反応温度は、通常20乃至150℃であ 50 り、好適には40℃乃至100℃である。反応時間は、 原料、溶媒、反応温度等によって異なるが、通常30分 乃至75時間であり、好適には1乃至24時間である。 【0064】反応終了後、本反応の目的化合物は常法に 従って反応混合物から採取することができる。例えば、 反応混合液から溶媒を留去して得られる残渣に水と混和 しない有機溶剤を加え、水洗後、溶剤を留去することに よって得られる。得られた化合物は必要ならば常法、例 えば再結晶、再沈殿またはクロマトグラフィーなどによ って更に精製することができる。

【0065】第B4工程は、化合物(9)のアミノ基の 10 保護基R6を除去して化合物(10)を製造する工程で ある。本工程は化合物(9)に溶媒中、脱保護剤を反応 させることによって達成される。脱保護剤は除去される アミノ基の保護基R6の種類によって異なるが、一般に この技術の分野で周知の方法をもちいて行われる。

【0066】R⁶がt-ブトキシカルボニル、ベンズヒドリルまたはトリチル基である場合、トリフルオロ酢酸、塩化水素、臭化水素、硫酸のような酸類を反応させることにより除去される。

【0067】R⁶が2、2-ジブロモエチルオキシカルボニル、2、2、2-トリクロロエチルオキシカルボニルのようなハロゲノアルキルオキシカルボニル基である場合、亜鉛のような金属類及び酢酸のような酸類の組み合わせを反応させることにより除去される。

【0068】R⁶がアリルオキシカルボニル、2-クロロアリルオキシカルボニルのような置換されていてもよいアリルオキシカルボニル基である場合、触媒量のテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウムの存在下に、2-エチルヘキサン酸ナトリウムのような有機カルボン酸アルカリ金属塩または水素化トリブチルスズを反 30 応させることにより除去される。

【0069】R⁶がベンジルオキシカルボニル、4-ニトロベンジルオキシカルボニルのような置換されていてもよいベンジルオキシカルボニル基の場合、パラジウム炭素等を触媒とする接触水素添加反応に付すことにより、除去される。

【0070】反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って酸性化合物との塩またはフリー体として反応混合物から採取される。例えば、脱保護剤として酸性化合物を使用した反応混合物より析出した目的化合物を沪取す 40 ることにより得られる。また、反応混合物を中和し、溶媒を留去して得られる残渣に水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、溶剤を留去することによって得られる。【0071】得られた化合物は必要ならば常法、例えば再結晶、再沈殿またはクロマトグラフィーなどによって更に精製することができる。

【0072】なお、本工程のR6の脱保護反応によって R4及びR5の保護基が除去されないように、R6の保護 基とR4及びR5の保護基の組み合わせを考慮すべきであ る。例えば、R6の保護基がt-ブトキシカルボニルのよ うな酸で除去される保護基である場合、R⁴及びR⁵の保 護基はベンジルオキシカルボニル、4ーニトロベンジル オキシカルボニルのような置換されていてもよいベンジ ルオキシカルボニル基またはアリルオキシカルボニル、 2-クロロアリルオキシカルボニルのような置換されていてもよいアリルオキシカルボニル基のような酸に対して安定な保護基を選択するのが好ましい。また、R⁶の 保護基がベンジルオキシカルボニル、4ーニトロベンジ ルオキシカルボニルのような置換されていてもよいベン ジルオキシカルボニル基のような接触水素添加で除去される保護基である場合、R⁴及びR⁵の保護基はt-ブトキ

18

【0073】第B5工程は、化合物(10)にアルキル基を導入して目的化合物(1)を製造する工程である。 本工程は化合物(10)に溶媒中、塩基の存在下または非存在下にアルキル化剤を反応させることによって達成される。

シカルポニルのような接触水素添加に対して安定な保護

基を選択するのが好ましい。

【0074】アルキル化剤としては、例えばギ酸ーホル マリン;ホルマリンーシアノ水素化ホウ素ナトリウム; ホルマリンー水素ーパラジウム炭素触媒若しくは酸化白 金;ジメチル硫酸、ジエチル硫酸のようなジアルキル硫 酸;ヨウ化メチル、ヨウ化エチルのようなハロゲン化ア ルキル類等を挙げることができ、好適にはギ酸ーホルマ リンまたはジアルキル硫酸(特にジメチル硫酸)であ

【0075】アルキル化剤の使用量は、化合物(10)に対して通常0.8乃至2モル当量であり、好適には0.9乃至1.2当量である。

【0076】出発原料の化合物(10)が酸性化合物との塩である場合には、塩基の存在下に行なうことが好ましい。使用される塩基としては、化合物の他の部分に影響を与えないものであれば特に制限はないが、例えばジイソプロピルエチルアミン、トリエチルアミンのようなトリアルキルアミン類; Nーメチルピペリジン、Nーメチルモルホリンのような飽和環状アミン類; ピリジン、4ージメチルアミノビリジンのような芳香族アミン類; 炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウムのようなアルカリ金属炭酸塩; 水酸化カリウム、水酸化ナトリウムのようなアルカリ金属炭酸塩; 水酸化カリウム、水酸化ナトリウムのようなアルカリ金属水酸化物を挙げることができ、好適にはトリアルキルアミン類(特にジイソプロビルエチルアミン)である。塩基の使用量は、化合物(10)に含まれる酸性化合物に対して1モル当量である。

【0077】使用される溶媒としては、反応を阻害せず 出発原料をある程度溶解するものであれば特に制限はな く、例えばアセトニトリルのようなニトリル類; 酢酸エ チルのようなエステル類; アセトン、メチルエチルケト ンのようなケトン類; ジクロロメタン、ジクロロエタ 50 ン、クロロホルムのようなハロゲン化炭化水素類; エー

テル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテ ル類;ジメチルスルホキシドのようなスルホキシド類; ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドのような アミド類;メタノール、エタノールのようなアルコール 類;水およびそれらの混合溶媒を挙げることができる が、好適にはニトリル類(特にアセトニトリル)、エス テル類(特に酢酸エチル)、エーテル類(特にテトラヒ ドロフラン) またはハロゲン化炭化水素類 (特にジクロ ロメタン) であり、特に好適にはアセトニトリルであ

【0078】反応温度は、通常-10乃至100℃であ り、好適には0℃乃至40℃である。反応時間は、原 料、溶媒、反応温度等によって異なるが、通常30分乃* [C法]

*至48時間であり、好適には1乃至24時間である。

20

【0079】反応終了後、本反応の目的化合物は常法に 従って反応混合物から採取することができる。例えば、 反応混合液から溶媒を留去して得られる残渣に水と混和 しない有機溶剤を加え、水洗後、溶剤を留去することに よって得られる。得られた化合物は必要ならば常法、例 えば再結晶、再沈殿またはクロマトグラフィーなどによ って更に精製することができる。

【0080】 [C法] C法は、上記のA法またはB法に 10 おいて使用される一般式(3)で表わされる化合物を製 造する方法である。

[0081] 【化5】

上記式中、n、A、R3、R4及びR5は前述と同意義で あり、R8はアミノ基の保護基を示し、X2は脱離基を示 す。

【0082】第C1工程は、化合物(12)にアミジノ

基を導入してグアニジノ化合物(14)を製造する工程 である。本工程は化合物(12)に溶媒中グアニジノ化 剤(13)を反応させることによって達成される。 【0083】グアニジノ化剤(13)は、式X2(C= NR4) NHR5 (式中、R4、R5及びX2は前述の通り である)で表わされる化合物またはその塩であれば特に 40 制限されない。脱離基X2としては、例えばピラゾリ ル、3-メチルピラゾリル、4-メチルピラゾリル、 3、5-ジメチルピラゾリル、メチルチオ、メタンスル ホニル、メタンスルフィニル、フェニルチオ、ペンゼン スルホニル、ベンゼンスルフィニル、メタンスルホニル アミノ、トリフルオロメタンスルホニルアミノ、ニト ロ、ニトロアミノ基等を挙げることができ、好適にはピ ラゾリル、3,5ージメチルピラゾリル、メチルチオま たはトリフルオロメタンスルホニルアミノ基である。化

※でき、好適には1/2硫酸塩である。

【0084】グアニジノ化剤の使用量は、化合物(1 2) に対して通常0.8乃至2モル当量であり、好適に は0.9乃至1.2当量である。

【0085】使用される溶媒としては、反応を阻害せず 出発原料をある程度溶解するものであれば特に制限はな く、例えばアセトニトリルのようなニトリル類:酢酸エ チルのようなエステル類;アセトン、メチルエチルケト ンのようなケトン類; ジクロロメタン、ジクロロエタ ン、クロロホルムのようなハロゲン化炭化水素類;エー テル、ジオキサン、テトラヒドロフランのようなエーテ ル類: ジメチルスルホキシドのようなスルホキシド類: ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミドのような アミド類: メタノール、エタノール、 t-ブタノールの ようなアルコール類;水およびそれらの混合溶媒を挙げ ることができるが、好適にはニトリル類 (特にアセトニ トリル)、エステル類(特に酢酸エチル)、エーテル類 (特にテトラヒドロフラン)、ハロゲン化炭化水素類 (特にジクロロメタン) またはアルコール類 (特にt-合物の塩としては塩酸塩、1/2硫酸塩等を挙げることが ※50 ブタノール)であり、特に好適にはアセトニトリルまた

はセーブタノールである。

【0086】反応温度は、通常0乃至150℃であり、 好適には20℃乃至90℃である。反応時間は、原料、 溶媒、反応温度等によって異なるが、通常15分乃至2 4時間であり、好適には1乃至8時間である。

【0087】反応終了後、本反応の目的化合物は常法に 従って反応混合物から採取することができる。例えば、 反応混合液から溶媒を留去して得られる残渣に水と混和 しない有機溶剤を加え、水洗後、溶剤を留去することに よって得られる。得られた化合物は必要ならば常法、例 10 えば再結晶、再沈殿またはクロマトグラフィーなどによ って更に精製することができる。

【0088】また、化合物(14)は酸性化合物との塩 として単離することもできる。酸性化合物の塩として は、次工程の反応を阻害しないものであれば特に限定は なく、例えばフッ化水素酸、塩酸、臭化水素酸、硫酸、 硝酸のような無機酸類との塩;炭酸、酢酸、トリフルオ 口酢酸、シュウ酸、フタル酸のような有機カルボン酸類 との塩;メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホ ン酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸のよう 20 な有機スルホン酸類との塩等を挙げることができるが、 好適には塩酸塩、硫酸塩、臭化水素酸塩またはトリフル オロ酢酸塩である。

【0089】或いは、グアニジノ化剤としてS-メチル チオ尿素・1/2硫酸塩のような塩を使用し、反応溶媒と してtーブタノールのようなアルコール類を使用した場 合、反応液にアセトンのような非プロトン性溶媒を加え ることによって目的化合物の塩を晶析させることもでき る。

の保護基R8を除去して目的化合物(3)を製造する方 法である。本工程は、第B4工程と同様にして達成する ことができる。

【0091】反応終了後、本反応の目的化合物は常法に 従って酸性化合物との塩またはフリー体として反応混合 物から採取される。例えば、酸性化合物との塩は、脱保 護剤として酸性化合物を使用した反応混合物より析出し た化合物を沪取することにより得られる。また、フリー 体は、反応混合物を中和し、溶媒を留去して得られる残 渣に水と混和しない有機溶剤を加え、水洗後、溶剤を留 40 去することによって得られる。得られた化合物は必要な らば常法、例えば再結晶、再沈殿またはクロマトグラフ ィーなどによって更に精製することができる。

【0092】化合物(3)の酸性化合物との塩として は、次工程の反応を阻害しないものであれば特に限定は なく、例えばフッ化水素酸、塩酸、臭化水素酸、硫酸、 硝酸のような無機酸類との塩;炭酸、酢酸、トリフルオ 口酢酸、シュウ酸、フタル酸のような有機カルボン酸類 との塩;メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホ ン酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸のよう 50 (S)-3-{2-{2,3-ビス (4 -ニトロベンジルオキ

な有機スルホン酸類との塩等を挙げることができるが、 好適には塩酸塩、硫酸塩、臭化水素酸塩またはトリフル オロ酢酸塩であり、特に好適には硫酸塩である。

22

【0093】なお、第B4工程のR6の保護基の除去に おけるのと同様に、本工程のR®の脱保護反応によって R4及びR5の保護基が除去されないように、R8の保護 基とR4及びR5の保護基の組み合わせを考慮すべきであ

【0094】A法またはB法で得られた化合物(1)は 酸性化合物との塩として単離することもできる。酸性化 合物の塩としては、例えばフッ化水素酸、塩酸、臭化水 素酸、硫酸、硝酸のような無機酸類との塩;炭酸、酢 酸、トリフルオロ酢酸、シュウ酸、フタル酸のような有 機カルボン酸類との塩:メタンスルホン酸、トリフルオ ロメタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンス ルホン酸のような有機スルホン酸類との塩等を挙げるこ とができるが、好適には塩酸塩または硫酸塩である。 【0095】以上のようにして得られた一般式(1)で 表わされるメルカプトピロリジン化合物及びその塩は、 4位メルカプト基の保護基R1を容易に除去し、カルバ ペネム骨格の2位側鎖として使用することができるの で、カルバペネム系抗菌剤の製造中間体として極めて有 用である。

[0096]

【実施例】以下、本発明を実施例及び参考例を挙げて更 に詳細に説明するが、本発明はこれらに制限されるもの ではない。尚、実施例及び参考例中の核磁気共鳴スペク トルにおいて、重水中の測定には特に断りのない限り、 トリメチルシリルプロピオン酸ナトリウムー d4を内部 【0090】第C2工程は、化合物(14)のアミノ基 30 標準物質として使用し、その他の溶媒ではテトラメチル シランを内部標準物質として使用して測定した。

【0097】実施例 1

(S) -3-(2-(2, 3-ビス(4-ニトロベンジル オキシカルボニル) グアニジノ]アセチルアミノ]ピロリ ジン・トリフルオロ酢酸塩

[0098]

【化6】

(1) 窒素気流中、参考例3の化合物(14.0g) のテトラヒドロフラン (300m1)溶液に1-H-ピ ラゾール[2, 3ーピス(4ーニトロベンジルオキシカ ルボニル)]カルボキサミジン(22.0g)を加え、 室温にて17時間撹拌した。溶媒を留去した後、酢酸エ チル(1000m1)を加え、水、硫酸水素カリウム水 溶液、飽和食塩水で順次洗浄した。有機層を無水硫酸ナ トリウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残留物を酢酸 エチルとイソプロピルエーテルで粉末化し、沪取して

シカルボニル) グアニジノ]アセチルアミノ]-1-(tert-ブチルオキシカルボニル)ピロリジン (24.2g) を得た。

【0099】赤外線吸収スペクトル (KBr) レcm⁻¹:33 17, 2977, 1739, 1690, 1646, 1523, 1410, 1348, 129 2, 1164, 1064.

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CDCl₃) るppm: 1.45 (9H, s), 1.73-1.89(1H, m), 2.07-2.21 (1H, m), 3.1 3-3.27 (1H, m), 3.30-3.49 (2H, m), 3.61 (2H, d, J=11.5, 6.2 Hz), 4.07 (2H, d, J=5.0 Hz), 5.21 (2H, s), 5.31 (2H, s), 6.23 (1H, d, J=6.7 Hz), 7.51-7.58 (4H, m), 8.17-8.29 (4H, m), 8.92 (1H, t, J=4.8 Hz), 11.65 (1H, s).

MSスペクトル m/z: 644 (M+1)+.

元素分析 (C28H33N7O11として計算)

計算值: C, 52.25%; H, 5.17%; N, 15.23%; O, 27.34%.

実**測値:** C, 51.71%; H, 5.00%; N, 15.17%; O, 27.22 %.

(2) 窒素気流中、氷冷下、実施例1-(1)の化合 20 物(12.00g)の塩化メチレン(48ml)溶液にトリフルオロ酢酸(24ml)を加え、氷冷下で3時間 撹拌した。反応混合物を減圧濃縮し、残留物をエーテルで粉末化した後、デカンテーションにより分離、減圧乾燥して、粉末の標記化合物(14.28g)を得た。

【0100】核磁気共鳴スペクトル (270 MHz, DMSOda) δ ppm: 1.75-1.85 (1H, m), 2.05-2.20 (1H, m), 2.85-3.05 (1H, m), 3.15-3.50 (3H, m), 3.90-4.05 (2 H, m), 4.15-4.35 (1H, m), 5.20 (2H, s), 5.39 (2H, s), 7.61 (2H, d, J=8.5 Hz), 7.70 (2H, d, J=8.5 Hz), 30 8.20-8.35 (4H, m)。 リエチルアミン (40 mg)を加え、参考例4で得点 た化合物 (88 mg)のテトラヒドロフラン (1 m l 溶液にクロロトリメチルシラン (59 mg)とトリコ ルアミン (55 mg)を加えた混合溶液を加え、室温 14時間撹拌した。反応混合物に酢酸エチル (50 m 1)を加え、希塩酸、炭酸水素ナトリウム水溶液、象

【0101】実施例 2

(S) -3-[2-[2, 3-ビス(4-ニトロベンジルオキシカルボニル) グアニジノ]アセチルアミノ]ピロリジン・2塩酸塩

[0102]

【化7】

窒素気流中、参考例4の化合物(3.05g)のN,Nージメチルホルムアミド(50m1)溶液にN,N'ービス(4-ニトロベンジルオキシカルボニル)ーSーメチルイソチオ尿素(5.61g)を加え、室温で4.5時間撹拌した。反応混合物に5%食塩水(400m1)を加え、酢酸エチル(400m1)で抽出した。有機層を5%食塩水で3回洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残留物をアセトニトリルに溶解し、4N塩化水素/酢酸エチルを加え室温で40分間撹拌した。反応混合物を減圧漂線1 配留物に酢酸エチル

24 で粉末化した後、沪取して、粉末の標記化合物(6.3 4g)を得た。

【0103】赤外線吸収スペクトル (KBr) νcm⁻¹:320 3, 3056, 2948, 2745, 1750, 1682, 1592, 1522, 1348, 1211, 1066.

核磁気共鳴スペクトル (400MHz, DMSO-ds) δppm: 1.7 4-1.88 (1H, m), 2.06-2.17 (1H, m), 2.92-3.04 (1H, m), 3.38-3.09 (3H, m), 3.87-4.06 (2H, n),4.24-4.38 (1H, m), 5.20 (2H, s), 5.39 (2H, s), 7.62 (2H, d, J=8.3 Hz), 7.71 (2H, d, J=8.4Hz), 8.22-8.28 (4H, m), 8.62 (1H, d, J=6.6 Hz), 8.12 (1H, s), 9.29 (1 H, s), 9.45 (1H, s)

MSスペクトル ■/z:544 (M+1)+...

【0104】実施例 3

(S) -3- [2-[3-(4-ニトロベンジルオキシ カルボニル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロリジン ・2塩酸塩

[0105]

【化8】

(1) 窒素気流中、4-二トロベンジルオキシカルボ ニルシアナミド (80mg) のテトラヒドロフラン (1 m1)溶液にクロロトリメチルシラン(43mg)とト リエチルアミン (40mg)を加え、参考例4で得られ た化合物 (88mg) のテトラヒドロフラン (1m1) 溶液にクロロトリメチルシラン (59mg) とトリエチ ルアミン (55mg)を加えた混合溶液を加え、室温で 1)を加え、希塩酸、炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和 食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減 圧下濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラ フィー (シリカゲル 10g ; メタノール : 酢酸エチル =98:2~90:10) に付し、粉末の(S)-1-(tert-ブチルオキシカルボニル)-3-[2-[3-(4-ニトロベンジルオキシカルボニル)グアニ ジノ] アセチルアミノ] ピロリジン (75mg)を得 た。

40 【0106】赤外線吸収スペクトル (KBr) νcm⁻¹:33 93,3316,2976,1662,1524,1415,1347,1291,116 6,1129,1110.

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CDC13) δ ppm: 1.44 (9H, s), 1.89-1.95(1H, m), 2.02-2.18 (1H, m), 3.1 7-3.30 (1H, m), 3.31-3.46 (3H, m), 3.57 (1H, d, J= 10.4, 6.1 Hz), 3.81-3.99 (2H, m), 4.23-4.41 (1H, m), 5.12 (2H, s), 7.41 (1H, br), 7.53 (2H, d, J=8.6 Hz), 8.20 (2H, d, J=8.6 Hz).

MSスペクトル m/z: 465 (M+1)+.

拌した。反応混合物を減圧濃縮し、残留物に酢酸エチル 50 (2) 窒素気流下、参考例4で得られた化合物(12

2mg) のメタノール (1m1) 溶液にN-(4-二ト ロベンジルオキシカルボニル) - S-メチルイソチオ尿 素(162mg)を加え、加熱し均一な溶液とした後、 溶媒を留去し、80℃で2時間、100℃で2時間反応 させた。反応混合物をシリカゲルカラムクロマトグラフ ィー(シリカゲル10g、酢酸エチル、続いて酢酸エチ ル:メタノール=90:10) に付し、粉末の(S)-1-(tert-ブチルオキシカルボニル)-3-[2 -[3-(4-ニトロベンジルオキシカルボニル)グア ニジノ] アセチルアミノ] ピロリジン (161mg) を 10 得た。スペクトルデータは実施例3-(1)の化合物に 一致した。

(3) 素気流中、実施例1-(1)で得られた化合物 (20g)のN, N-ジメチルホルムアミド (200m) 1)溶液にチオ酢酸(3.33m1)と炭酸セシウム (7.59g)を加え、室温で一夜撹拌した。反応混合 物に酢酸エチル(21)を加え、有機層を10%食塩水、 飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し た後、減圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマ ノール=95:5、続いて酢酸エチル:メタノール=9 0:10) に付し、イソプロピルエーテルで粉末化、洗 浄して、粉末の(S)-1-(tert-ブチルオキシカルボニル) ピロリジン-3-[2-[3-(4-ニト ロベンジルオキシカルボニル) グアニジノ] アセチルア ミノ] (13.83g)を得た。スペクトルデータは実 施例3 - (1)の化合物に一致した。

(4) 窒素気流中、実施例3-(2)で得られた化合 物(11.8g)のアセトニトリル(95ml)溶液に 4 N塩化水素/酢酸エチル (95 m 1) を加え、25℃ 30 MSスペクトル m/z:729 (M+1)+。 で1.5時間撹拌した。反応混合物を減圧濃縮し、酢酸 エチルを加え粉末化した後、沪取して、粉末の標記化合 物(10.6g)を得た。

【0107】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν cm⁻¹:33 61, 3035, 2733, 1742, 1695, 1630, 1555, 1519, 134 5, 1255, 1233, 1183.

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, D₂0) δ ppm: 2.02-2.12 (1H, m), 2.34-2.44 (1H, m), 3.30 (1H, dd, J=1 2.6, 4.8 Hz), 3.38-3.52 (2H, m), 3.60 (1H,dd, J=1 2.6, 7.1 Hz), 4.18 (2H, s), 4.48-4.55 (1H, m), 5.4 40 2 (2H, s), 7.65(2H, d, J=8.7 Hz), 8.28 (2H, d, J= 8.7 Hz).

MSスペクトル m/z: 365(M+1)+。

【0108】実施例 4

【化9】

(2S, 4S) -4-アセチルチオ-1-メチル-2-[(35)-3-[2-[2,3-ピス(4-ニトロベ ンジルオキシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミ ノ] ピロリジンー1ーイルカルボニル] ピロリジン [0109]

26

窒素気流中、氷冷下、参考例1で得られた化合物(20 g) のアセトニトリル溶液 (400ml) に、N、N-ジイソプロピルエチルアミン (70g)、塩化ビバロイ ル(12.5g)を加え、1時間撹拌した。反応液を一 5℃に冷却後、実施例2で得られた化合物(62.2 g) とN, N-ジイソプロピルアミン(25.4g)の アセトニトリル溶液(400ml)を加え、2時間撹拌 した。反応混合物にアセトニトリル(700m1)、酢 酸エチル (1.51) を加え、有機層を10%食塩水、 及び飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで 乾燥した後、減圧下濃縮した。残留物をシリカゲルカラ ムクロマトグラフィー (シリカゲル2kg、酢酸エチ ル:メタノール=9:1-8:2) に付し、アモルファス 状の標記化合物(47.1g)を得た。

【 O 1 1 O 】 赤外線吸収スペクトル (KBr) ν cm⁻¹: 33 トグラフィー (シリカゲル420g、酢酸エチル:メタ 20 07, 2950, 1739, 1686, 1643, 1552, 1523, 1441, 134 8, 1292, 1106, 1064.

> 核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CDCl₃) δ ppm: 1.75 -2.30 (3H, m), 2.28,2.30, (3H, sx2), 2.32, 2.35 (3 H, sx2), 2.59-2.70 (1H, m), 2.74-2.88 (1H, m), 3.03-3.20 (2H, m), 3.41-3.49 (1H, m), 3.52-3.78 (2H, m)m), 3.79–3.85(1H, m), 3.91–4.11 (2H, m), 4.39–4.51 (1H, m), 5.17-5.29 (2H, m), 5.31(2H, s), 6.51, 6. 71 (1H, dx2, J=7.1Hz), 7.52-7.58 (4H, m), 8.19-8.2 8 (4H, m), 8.86-8.94 (1H, m).

【0111】実施例 5

(28, 48) -4-アセチルチオ-1-メチル-2-[(3S)-3-[2-[3-(4-ニトロベンジルオ キシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロリ ジン-1-イルカルボニル] ピロリジン

[0112]

【化10】

(1) 窒素気流中、氷冷下、参考例1で得られた化合 物(465mg)のアセトニトリル溶液(10ml) に、N, N-ジイソプロピルエチルアミン(1.63 g)、塩化ピパロイル (289mgを)加え、1時間撹 拌した。反応液を-5℃に冷却後、実施例3-(3)で 得られた化合物(1.0g)とN, N-ジイソプロピル アミン(1.48g)のアセトニトリル(15ml)溶 液を加え、2時間撹拌した。反応混合物に酢酸エチル 50 (100ml)を加え、有機層を10%食塩水、及び飽 和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥し た後、減圧下濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロ マトグラフィー (シリカゲル40g、酢酸エチル:メタノ ール=9:1、続いて酢酸エチル:メタノール=5:1) に付し、アモルファス状の標記化合物 (782mg)を 得た。

【0113】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν cm⁻¹: 32 95, 2950, 1685, 1639, 1549, 1522, 1448, 1347, 129 0. 1110.

MSスペクトル m/z:550 (M+1)+.

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CD30D) δ ppm: 1.70-1.78 (1H, **m**), 1.85-2.04 (1H, **m**), 2.11-2.26 (1H, m), 2.28, 2.29 (3H, $s\times 2$), 2.34, 2.36 (3H, $s\times 2$), 2.70-2.83 (1H, m), 2.89-2.97 (1H, m), 3.03-3.08 (1 H, \mathbf{n}), 3.20-3.43(3H, \mathbf{n}), 3.54-3.74 (3H, \mathbf{n}), 3.84-4.12 (4H, m), 4.34-4.45 (1H, m), 7.60-7.63 (2H, m), 8.22-8.24 (2H, m).

元素分析 (C23H31N7O7Sとして計算)

計算值:C, 49.45%; H, 5.77%; N, 17.55%; S, 5.74%. 実測值: C, 48.29%; H, 5.50%; N, 17.45%; S, 5.31%. (2) 窒素気流中、氷冷下、参考例1で得られた化合 物 (500mg) とN, N-ジイソプロピルエチルアミ ン (0.47ml)のアセトニトリル溶液 (10ml) に、塩化ビバロイル(0.31ml)を滴下し30分間 撹拌した。反応液にN、N-ジイソプロピルアミン

(1.5m1)を加え、実施例3で得られた化合物 (1.08g)を5℃以下に保ち少量ずつ加えた後1時 間撹拌した。 反応混合物に酢酸エチルを加え、 5%食塩 水、及び飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウ カラムクロマトグラフィー (10%メタノール/酢酸工 チル、続いて20%メタノール/酢酸エチル) に付し、 アモルファス状の標記化合物 (1.00g)を得た。ス ペクトルデータは実施例5-(1)の化合物に一致し た。

【0114】実施例 6

(2S, 4S) - 4 - 7 + 2 + 4 + 4 + 1 - (tert - 4)ブチルオキシカルボニル) -2-[(35)-3-[2 -[3-(4-ニトロベンジルオキシカルボニル)グア ニジノ] アセチルアミノ] ピロリジンー1-イルカルボ 40 ル)-2- [(3S)-3- [2- [2,3-ビス(4 ニル] ピロリジン

[0115]

(1) 窒素気流中、N-Boc-trans-tドロ キシーLープロリン (833mg) のアセトニトリル

(20m1)溶液に1,1'-カルボニルジイミダゾー ル(632mg)を加え、室温で1時間撹拌した後、実 施例1 - (2)で得られた化合物(1.97g)とN, N-ジイソプロピルエチルアミン (427mg) のアセ トニトリル(40m1)溶液を加え、室温で1時間撹拌 した。反応混合物に酢酸エチルを加え、希塩酸、炭酸水 素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で順次洗浄した後、減 圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフ ィー(シリカゲル120g、酢酸エチル、続いて酢酸エ 10 チル:メタノール=86:14) に付し、アモルファス 状の(2S, 4R) - 4 -ヒドロキシ-1 -(tert ープチルオキシカルポニル)-2- [(3S)-3-[2-[2,3-ビス(4-ニトロベンジルオキシカル ボニル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロリジン-1 -イルカルボニル] ピロリジン (2.03g) を得た。 【0116】赤外線吸収スペクトル (KBr) νcm¹:32 98, 1739, 1644, 1555, 1523, 1347, 1292, 1212, 1160, 1064.

28

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CDC13) δ ppm: 1.41 (9H, s), 1.91-2.30(2H, m), 3.25-3.32 (1H, m), 3.4 3-3.56 (2H, m), 3.68-3.73 (1H, m), 3.95-4.13 (4H, \blacksquare), 4.48-4.62 (3H, \blacksquare), 5.17-5.22 (2H, \blacksquare), 5.29-5.3 2 (2H, m), 7.50-7.59 (4H, m), 7.68-7.72 (1H, m), 8.20-8.29 (4H, m), 8.85-9.00 (2H, m). MSスペクトル m/z: 757(M+1)+.

(2) 窒素気流中、実施例6-(1)で得られた化合 物(357mg)のテトラヒドロフラン(5ml)溶液 に塩化メタンスルホニル (59mg)、トリエチルアミ ン (52mg)を加え、0℃で2時間撹拌した。さらに ムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残留物をシリカゲル 30 塩化メタンスルホニル(118mg)、トリエチルアミ ン (104mg) を加え、0℃で2時間撹拌した。反応 混合物に酢酸エチル(150ml)を加え、炭酸水素ナ トリウム水溶液 (50ml)、飽和食塩水 (50ml) で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧 下濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフ ィー (シリカゲル35g、酢酸エチル:メタノール=9 5:5、続いて酢酸エチル:メタノール=90:10) に付し、無色粉末の(2S, 4R)-4-メチルスルホ ニルオキシ-1-(tert-ブチルオキシカルボニ ーニトロベンジルオキシカルボニル) グアニジノ] アセ チルアミノ] ピロリジン-1-イルカルボニル] ピロリ ジン(278mg)を得た。

> 【0117】赤外線吸収スペクトル (KBr) νcm⁻¹:33 26, 2976, 1739, 1696, 1646, 1524, 1348, 1170, 106

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CDCl₃) δ ppm : 1.4 1, 1.42 (9H, sx2), 2.05-2.19 (1H, n), 3.05, 3.07 (3H, sx2), 3.25-4.12 (8H, m), 4.49-4.62 (2H, m), 5. 50 15-5.36 (5H, **m**), 7.52-7.59 (4H, **m**), 8.19-8.28 (4H,

MSスペクトル m/z: 835 (M+1)+.

m), 8.89-9.02(1H, m).

(3) 窒素気流中、実施例6-(2)で得られた化合 物(280mg)のN, N-ジメチルアセトアミド (4.2ml)溶液にチオ酢酸(87mg)と炭酸セシ ウム (201mg) を加え、70℃で1時間、80℃で 2.5時間撹拌した。反応混合物に酢酸エチル(60m 1)を加え、有機層を10%食塩水、炭酸水素ナトリウム 水溶液、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウ ラムクロマトグラフィー (シリカゲル15g、酢酸エチ ル:メタノール=95:5、続いて酢酸エチル:メタノ ール=98:12)に付し、アモルファス状の標記化合 物(106mg)を得た。

【0118】核磁気共鳴スペクトル (400 Miz, CDCl3) $\delta ppm : 1.41 \text{ (9H, s)}, 1.68-2.21 \text{ (3H, m)}, 2.35 \text{ (3H, m)}$ s), 2.53-2.63 (1H, m), 3.25-4.02 (9H, m), 4.18-4.2 7 (2H, ■), 5.18 (2H, s), 7.55 (2H, d, J=8.8 Hz), 7.84 (1H, d, J=7.5 Hz), 8.21 (2H, d, J=8.8 Hz). (4) 窒素気流中、N-Boc-trans-tドロ 20 キシーLープロリン (139mg) のアセトニトリル (2m1)溶液に1,1'-カルボニルジイミダゾール (105mg)を加え、室温で1時間撹拌した後、実施 例3-(3)で得られた化合物(200mg)とN, N ージイソプロピルエチルアミン (71mg)のメタノー ル(1ml)溶液を加え、室温で7時間撹拌し、N,N ージイソプロピルエチルアミン (36mg) を加えた 後、さらに16時間撹拌した。反応混合物を減圧濃縮 し、残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (シ て酢酸エチル:メタノール=7:3)に付し、アモルフ rス状の(2S, 4R)-4-ヒドロキシ-1-(te rt-ブチルオキシカルボニル)-2-[(3S)-3 - [2-[3-(4-ニトロベンジルオキシカルボニ ル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロリジン-1-イ ルカルボニル] ピロリジン (129mg) を得た。 【0119】核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CDCl3) δ ppm : 1.46 (9H, s), 1.80-2.21(2H, m), 3.35-4.05 (9H, ■), 4.43-4.60 (3H, ■), 5.19 (2H, s), 5.58-5.6 2 (1H, \mathbf{m}), 7.55-7.59 (2H, \mathbf{m}), 7.74-7.80 (1H, \mathbf{m}), 8.19-8.22 (2H, m).

(5) 窒素気流中、実施例7-(4)で得られた化合 物 (578 mg)、トリエチルアミン $(168 \mu 1)$ と、4-ジメチルアミノビリジン(29mg)のアセト ニトリル (10m1)溶液に、塩化メタンスルホニル (93µ1を滴下し、0℃で2.5時間撹拌した。反応 混合物に酢酸エチルを加え、炭酸水素ナトリウム水溶 液、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾 燥した後、減圧下濃縮した。残留物をシリカゲルカラム

5、続いて酢酸エチル:メタノール=90:10)に付 し、アモルファス状の (2S, 4R) -4-メチルスル ホニルオキシ-1-(tert-ブチルオキシカルボニ ル) -2-[(3S) -3-[2-[3-(4-ニトロ ベンジルオキシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミ ノ] ピロリジン-1-イルカルボニル] ピロリジン (1 88mg)を得た。

【0120】核磁気共鳴スペクトル(400 MHz, CDCl3) $\delta ppm : 1.39, 1.42 \text{ (9H, sx2)}, 2.29-2.58 \text{ (2H, m)},$ ムで乾燥した後、減圧濃縮した。残留物をシリカゲルカ 10 3.07, 3.08 (3H, sx2), 3.38-4.05 (9H, m), 4.42-4.58 (1H, m), 4.52-4.59 (1H, m), 5.18 (2H, s), 5.25-5.36 (1H, m), 7.54 (2H, d, J=8.5 Hz), 7.69 (1H, d, J= 7.7 Hz), 8.20 (2H, d, J=8.5 Hz). MSスペクトル m/z: 656(M+1)+.

(6) 窒素気流中、N-Boc-trans-tドロ キシーレープロリン (347mg) のアセトニトリル (5m1)溶液に塩化メタンスルホニル (344m) g)、N, N-ジイソプロピルエチルアミン(465m g)を加え、-10℃で1時間撹拌した後、実施例3-(4)で得られた化合物(400mg)とN, N-ジイ ソプロピルエチルアミン (310mg)のN, N-ジメ チルホルムアミド溶液 (5ml) を加え、室温で1時間 撹拌した。反応混合物に酢酸エチル (100ml)を加 え、有機層を10%食塩水(50mlで2回)、飽和食 塩水50m 1 で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し た後、減圧下濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロ マトグラフィー(シリカゲル20g、酢酸エチル:メタノ ール=95:5、続いて酢酸エチル:メタノール=9 0:10)付し、アモルファス状の(2S, 4R)-4 リカゲル15g、酢酸エチル:メタノール=9:1、続い 30 ーメチルスルホニルオキシー1-(tert-ブチルオ キシカルボニル) -2-[(3S)-3-[2-[3-(4-ニトロペンジルオキシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロリジン-1-イルカルボニル] ピ ロリジン (206mg) を得た。 スペクトルデータは実 施例6-(5)の化合物に一致した。

> (7) 窒素気流中、実施例6-(2)で得られた化合 物(227mg)のN, N-ジメチルアセトアミド (2.7m1)溶液にチオ酢酸(35mg)と炭酸セシ ウム (75mg)を加え、室温で7時間撹拌した。反応 混合物に酢酸エチル(100ml)を加え、有機層を10 %食塩水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシ ウムで乾燥した後、減圧濃縮した。残留物をシリカゲル カラムクロマトグラフィー (シリカゲル15g、酢酸エチ ル:メタノール=95:5、続いて酢酸エチル:メタノ ール=90:10) に付し、アモルファス状の(2S, 4R) -4-メチルスルホニルオキシ-1-(tert ーブチルオキシカルボニル) -2-[(3S)-3-[2-[3-(4-ニトロベンジルオキシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロリジン-1-イルカ

クロマトグラフィー (酢酸エチル:メタノール=95: 50 ルボニル] ピロリジン (138mg) を得た。スペクト

ルデータは実施例6-(5)の化合物に一致した。

(8) 窒素気流中、実施例6-(7)で得られた化合 物(135mg)のN, N-ジメチルアセトアミド(4 m1)溶液にチオ酢酸(27mg)と炭酸セシウム(7 5mg)を加え、60℃で2時間、70℃で3.5時間 撹拌した。反応混合物に酢酸エチル (60m1)を加 え、有機層を10%食塩水、炭酸水素ナトリウム水溶液、 飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥 した後、減圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロ ノール=95:5、続いて酢酸エチル:メタノール=9 0:10) に付し、アモルファス状の標記化合物(69 mg)を得た。スペクトルデータは実施例6-(3)の 化合物に一致した。

【0121】実施例 7

(25, 45) -4-アセチルチオ-1-メチル-2-[(3S)-3-[2-[3-(4-ニトロベンジルオ キシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロリ ジン-1-イルカルボニル] ピロリジン

[0122]

【化12】

氷冷下、実施例6-(8)で得られた化合物(0.52 g) の塩化メチレン (2.00ml) 溶液に、4 N塩化水 素/酢酸エチル(0.821)を加え、5分間撹拌した 後、反応混合物にエーテルを加えて粉末化し、デカンテ ーションにより分離、洗浄、減圧乾燥した。氷冷下、得 30 られた粉末のアセトニトリル (10ml) 懸濁液に、N. N-ジイソプロピルエチルアミン(0.141)を加え 5分間撹拌した後、減圧濃縮した。残留物に蟻酸(0. 1 2 🛮 1)とホルマリン(0.1 9 🗷)を加え、5 5 ℃で 1.5時間撹拌した後、反応混合物を減圧濃縮した。残 留物にアセトン及びエチルエーテルを加え粉末化、沪取 した。得られた粉末を逆相シリカゲルカラムクロマトグ ラフィー (ナカライテスク製コスモシール75C18-PREP、15g) に付し、水-アセトニトリル (8) 0:20)にて溶出した画分を集め、粉末状の標記化合 40 物(0.17g)を得た。スペクトルデータは実施例5 (1)の化合物に一致した。

【0123】実施例 8

· (S)-1-(tert-ブチルオキシカルボニル)-3-[2-[3-(4-ニトロベンジルオキシカルボニ ル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロリジン

[0124]

【化13】

素気流中、実施例1 - (1)で得られた化合物(20 g)のN, N-ジメチルホルムアミド (200ml)溶 液にチオ酢酸(3.33ml)と炭酸セシウム(7.5 9g)を加え、室温で一夜撹拌した。反応混合物に酢酸 エチル(21)を加え、有機層を10%食塩水、飽和食塩 水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減 マトグラフィー(シリカゲル15g、酢酸エチル:メタ 10 圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフ ィー (シリカゲル420g、酢酸エチル:メタノール= 95:5、続いて酢酸エチル:メタノール=90:1 0)に付し、イソプロピルエーテルで粉末化、洗浄し て、粉末の標記目的化合物 (13.83g) を得た。ス ペクトルデータは実施例3 - (1)の化合物に一致し た。

【0125】実施例 9

(S) -3- [2-[3-(4-ニトロベンジルオキシ カルボニル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロリジン

20 [0126]

8, 1292.

【化14】

実施例3-(3)で得られた化合物(2.5g)をイオン 交換樹脂 [DIAION/PA312, メタノール (1.51)]で精製し、流出液を減圧濃縮した後、残留 物をイソプロビルエーテルで結晶化、洗浄、減圧乾燥し て、粉末状の標記目的化合物(1.93g)を得た。 【0127】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν cm⁻¹:33 83, 3307, 1656, 1608, 1553, 1521, 1433, 1382, 134

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CD₃OH) δ ppm: 1.62 -1.75 (1H, \mathbf{m}), 2.00-2.14 (1H, \mathbf{m}), 2.70 (1H, dd, J=11.8, 4.6 Hz), 2.81-3.11 (3H, \blacksquare), 3.87 (3H, s), 4. 21-4.36 (1H, m), 5.20 (2H, s), 7.61 (2H, d, J=8.6 Hz), 8.22 (2H, d, J=8.6 Hz).

MSスペクトル m/z: 365(M+1)+。

【0128】実施例 10

(S) -3- [2-[3-(4-ニトロベンジルオキシ カルボニル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロリジン · 2硫酸塩

[0129]

【化15】

(1) 参考例4-(2)で得られた化合物(5.00 g) のt-ブタノール (100ml) 溶液にN-(4-二

50 トロベンジルオキシカルボニル) - S-メチルイソチオ

【0134】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max c **m**⁻¹: 1751, 1725, 1696, 1410, 1366, 1350, 1178, 116

34

で6時間加熱還流した。反応混合物にアセトン(200 ml)を加え0~5℃に冷却下30分間撹拌した後、析出 した結晶を**沪取、乾燥して(S)-1-(tert-ブ** チルオキシカルボニル) -3- [2-[3-(4-ニト ロベンジルオキシカルボニル)グアニジノ]アセチルア ミノ] ピロリジン・1/2硫酸塩 (10.50g) を得

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CDCl3) 8 ppn: 1.4 5, 1.47 (18H, s×2),2.19-2.26 (1H, n), 2.52-2.69 (1H, m), 3.05 (3H, s), 3.70-3.88 (2H, m), 4.28-4.3 6 (1H, ■), 5.23-5.25 (1H, ■).

【0130】核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CDCl3) $\delta ppm : 1.41 \text{ (9H, s)}, 1.60-2.15 \text{ (6H, m)}, 3.18-3.57$ (4H, n), 4.05-4.35 (3H, n), 5.26 (2H, s), 7.53 (2H, s)H, d, J=8.1 Hz), 8.17 (2H, d, J=8.1 Hz).

(2) 参考例1-(1)で得られた化合物(3.0 g) のN, N-ジメチルアセトアミド (30ml)溶液 10 に、チオ酢酸 (1.1g) と炭酸セシウム (2.3g) を 加え、70℃で1.5時間撹拌した。反応混合物に酢酸 エチル(1501)を加え、10%食塩水(1001 1)、水(100ml)及び飽和食塩水(100ml)の順で 洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥、減 圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフ ィー (関東化学製シリカゲル60N:150g、ベンゼ ン: アセトニトリル=95:5) に附し、粉末状の(2 S, 4S) - 4 - P + f + J + 1 - (tert - J)キシカルボニル) ピロリジンカルボン酸・tert-ブ

(2) 0℃に冷却したメタノール(65m1)に濃硫 酸(3.6ml)を滴下し、実施例10-(1)で得ら れた化合物 (10.00g) を加えた。内温40℃で2 時間撹拌し、25℃まで冷却した後、ジイソプロピルエ ーテル (100ml) を加え1.5時間撹拌した。析出 した結晶を沪過、乾燥して、粉末の標記化合物(10. 9g)を得た。

> 【0135】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max c **1** 1751, 1703, 1397, 1366, 1254,1149, 1123, 111

【0131】核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, D₂0) δ 20 チルエステル (2.3g) を得た。 ppm : 1.85-1.96 (1H, m), 2.10-2.25 (1H, m), 3.13-3.44 (4H, m), 4.01 (2H, s), 4.31-4.39 (1H, m), 5.2 5 (2H, s), 7.48 (2H, d, J=8.6 Hz), 8.10 (2H, d, J= 8.6 Hz).

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 1.44 -1.48 (18H, m), 1.89-1.97 (1H, m), 2.32 (3H, s), 2.65-2.80 (1H, m), 3.27-3.39 (1H, m), 3.91-4.01 (2 H, m), 4.16-4.27 (1H, m).

【0132】参考例 1

(3) 参考例1-(2)で得られた化合物(0.69 g) の蟻酸(3.5ml)溶液に、4N塩化水素/酢酸工 30 チル(0.751)を加え、45℃で13.5時間撹拌 した。反応混合物を減圧濃縮した後、残留物にエチルエ ーテルを加えて粉末化し、沪取、減圧乾燥して、粉末状 の(2S, 4S) -4-アセチルチオ-2-ピロリジン カルボン酸·塩酸塩(0.42g)を得た。

(2S, 4S) - 4-アセチルチオ-1-メチル-2-ピロリジンカルボン酸

> 核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, D20) δ ppm: 2.21-2.30 (1H, m), 2.38 (3H,s), 2.86-2.93 (1H, m), 3.42 -3.47 (1H, m), 3.84-3.89 (1H, m), 4.13-4.20(1H, m), 4.47-4.51 (1H, m).

[0133]

【化16】

(4) 氷冷下、実施例1-(3)で得られた化合物 (0.42g)の塩化メチレン(5ml)懸濁液に、N, N-ジイソプロピルエチルアミン(0.29ml)を加 え、同温で1時間撹拌した後、減圧濃縮した。残留物に 蟻酸(0.29㎜)とホルマリン(0.45㎜)を加 え、55℃で1時間撹拌した。反応混合物を減圧濃縮 し、残留物をエチルエーテルで洗浄、デカンテーション により分離して、逆相シリカゲルカラムクロマトグラフ ィー (ナカライテスク製コスモシール75C18-PR EP 15g) に附し、水にて溶出した画分を集め、粉 末状の標記化合物(0.21g)を得た。

(1) (2S, 4R) - 1 - (tert - 7) + 5ルボニル) -4-ヒドロキシピロリジンカルボン酸·t ertーブチルエステル(3.0g)を、テトラヒドロ フラン (30ml) に溶解し、氷冷下、N, N-ジイソプ ロピルエチルアミン (3.2g)を加え、次いで、塩化 メタンスルホニル (2.8g)を滴下し、同温で2時間 撹拌した後、室温で一夜放置した。不溶物を沪別し、減 40 圧濃縮した後、残留物に酢酸エチル (150 ml)を加 え、水 (100ml) 続いて飽和食塩水 (100ml) の順 で洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減 圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフ ィー (関東化学製シリカゲル60N:180g、シクロ ヘキサン:酢酸エチル=65:35、続いてシクロヘキ サン: 酢酸エチル=60:40) に付し、粉末状の(2 $S, 4R) - 1 - (tert - 7) + 3 \lambda \mu \pi \mu - 1$ 4-メチルスルホニルオキシピロリジンカルボン酸・t ert-ブチルエステル(3.5g)を得た。

50 【0136】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max c

■1: 1699, 1683, 1622, 1361, 1307,1202, 1116. 核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, №0) δ ppm: 2.16—2.22 (1H, m), 2.38 (3H, s), 2.96—3.04 (1H, m), 2.9 9 (3H, s), 3.69—3.78 (2H, m), 4.06—4.10 (1H, m), 4.22—4.28 (1H, m).

(5) 参考例1-(2)で得られた化合物(0.69g)を蟻酸(3.5ml)に溶解し、4N塩化水素/酢酸エチル(0.75ml)を加え、45℃で15時間撹拌した後、N,Nージイソプロピルエチルアミン(0.46ml)とホルマリン(5.30ml)を加え、55℃で1.5時間撹拌した。反応混合物を減圧濃縮し、残留物をヘキサン、エチルエーテルの順に洗浄しデカンテーションにより分離した後、逆相シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ナカライテスク製コスモシール75C18-PEP 15g)に附し、水にて溶出した画分を集め、粉末状の標記化合物(0.18g)を得た。各種スペクトルデータは参考例1-(4)の化合物に一致した。

【0137】参考例 2

(2S, 4S) -4-ベンゾイルチオ-1-メチル-2 -ピロリジンカルボン酸

[0138]

【化17】

(1) (2S, 4R) -1-アリルオキシカルボニルー4-メシルオキシー1-ピロリジンカルボン酸・アリルエステエル(6.60g)をN, N-ジメチルホルムアミド(135ml)に溶解し、チオ安息香酸カリウム(7.00g)を加え、70℃で2時間撹拌した。反応混合物に酢酸エチル(500ml)を加え、10%食塩水(300ml)、水(300ml)及び飽和食塩水(300ml)の順で洗浄し、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(メルク製シリカゲル60:150g、ベンゼン:アセトニトリル=99:1)に附し、油状の(2S, 4S)-1-(アリルオキシカルボニル)-4-ベンゾイルチオー2-ピロリジンカルボン酸・アリルエステル(5.60g)を得た。

【0139】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max c m⁻¹: 1751, 1710, 1666, 1449, 1407,1341, 1210, 1189, 1177.

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CDCl₃) δ ppm: 2.10-2.20 (1H, m), 2.82-2.96 (1H, m), 3.49-3.58 (1H, m), 4.16-4.24 (2H, m), 4.47-4.72 (5H, m), 5.12-5.36 (4H, m), 5.83-5.99 (2H, m), 7.44-7.50 (2H, m), 7.54-7.61 (1H, m), 7.90-7.92 (2H, m).

(2) 参考例2-(1)で得られた化合物(0.38g)、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウ

ム(0)(0.06g)及び、酢酸(0.30g)の塩化メチレン(20ml)溶液に、室温にて、水素化トリーnーブチルすず(0.64g)を加え30分間撹拌した。反応混合物に、ピリジン(0.40ml)を加え、減圧濃縮した後、残留物を逆相シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ナカライテスク製コスモシール75C18-PREP 15g)に附し、水ーメタノール(50:50)にて溶出した西分を集め、粉末状の(2S,4S)-4-ベンゾイルチオー2-ピロリジンカルボン酸(0.23 10 g)を得た。

36

【 O 1 4 O 】 赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max c m⁻¹: 1620, 1581, 1450, 1389, 1360,1320, 1212. 核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CD₃OD-D₂O) δ ppm: 2.42-2.31 (1H, m), 2.89-2.96 (1H, m), 3.45-3.49 (1H, m), 3.88-3.93 (1H, m), 4.19-4.34 (2H, m), 7.53-7.58 (2H, m), 7.69-7.73 (1H, m), 7.94-7.97 (2H, m).

(3) 参考例2-(2)で得られた化合物(0.19g)に、蟻酸(0.11ml)とホルマリン(0.15m
 20 1)を加え、55℃で1時間撹拌した。反応混合物を減圧濃縮し、残留物をエチルエーテルで洗浄しデカンテーションにより分離した後、逆相シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ナカライテスク製コスモシール75C18-PREP 15g)に附し、ホーメタノール(50:50)にて溶出した画分を集め、アモルファス状の標記化合物(0.12g)を得た。

【0141】核磁気共鳴スペクトル (270 MHz, CD₂OD) δ ppm: 2.20-2.38 (1H, m), 2.45-2.82 (1H, m), 3.00 (3H, s), 3.52-4.55 (4H, m), 7.38-7.56 (2H, m), 7. 30 59-7.73 (1H, m).7.83-8.00(2H, m)。

【0142】参考例 3

(3S) -3- (2-アミノアセチル) アミノ-1-(tert-ブチルオキシカルボニル) ピロリジン 【0143】

【化18】

(1) 2―グリシン(15.37g)のアセトニトリ 40 ル(220ml)懸濁液にN,N-カルボニルジイミダゾール(12.48g)を加え室温で1時間撹拌した。反 応混合物を氷冷下、(3S)-3-アミノー1ー(tertーブチルオキシカルボニル)ピロリジン(13.03g)のアセトニトリル(100ml)溶液を滴下し室温で1.5時間撹拌した。反応混合物を減圧濃縮し、残留物を酢酸エチルに溶解し水、続いて飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥た後、減圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=2:8、ヘキサン:酢酸エチル=1:9続50いて酢酸エチル)に付し、無色アモルファスの(3S)

-3-(2-ベンジルオキシカルボニルアミノアセチ ル) アミノー1-(tert-ブチルオキシカルボニ ル) ピロリジン (21.38g) を得た。

37

【 O 1 4 4 】核磁気共鳴スペクトル(270 MHz, CDCl3) $\delta ppm : 1.46 \text{ (9H, s)}, 1.70-1.90 \text{ (1H, br)}, 2.06-2.20$ (1H, m), 3.05-3.26 (1H, br), 3.30-3.47 (2H, br), 3.55-3.66 (1H, m), 3.84 (2H, d, J=5.7 Hz), 4.37-4. 50 (1H. m), 5.13 (2H, s), 5.40-5.56 (1H, br), 6.38-6.45 (1H, br), 7.35 (5H, s).

(2) 参考例3-(1)の化合物(21.38g)の エタノール (3501)溶液に7.5%パラジウムー炭 素触媒 (6.0g) を加え、35℃、1気圧で20分間 水素を吸収させた。触媒を沪別した後、減圧濃縮して無 色飴状の標記化合物(13.94g)を得た。

【0145】核磁気共鳴スペクトル (270 Miz, CDCl3) δ ppm: 1.46 (9H, s), 1.73-1.93(1H, br), 2.08-2.2 6 (1H, m), 3.08-3.57 (3H, m), 3.35 (2H, s), 3.57-3.70(1H, m), 4.40-4.56(1H. m).

【0146】参考例 4

(3S) -3-(2-アミノアセチル) アミノ-1-(tert-ブチルオキシカルボニル) ピロリジン [0147]

【化19】

(1) 窒素気流中、氷冷下(S)-3-アミノ-1-(tert-ブチルオキシカルボニル) ピロリジン (5.5g) の塩化メチレン (55m1)溶液に、トリ エチルアミン(3.29g)とクロロアセチルクロリド 30 (5.5g)を加え、室温で2時間撹拌した。反応混合 物に酢酸エチル(200m1)を加え、有機層を水、飽 和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した 後、減圧下濃縮して、無色粉末の(S)-3-クロロア セチルアミノー1-(tert-ブチルオキシカルボニ ルピロリジン(7.75g)を無色粉末として得た。 【0148】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν cm⁻¹:33 28, 2978, 1671, 1547, 1421, 1367, 1159, 1112. 核磁気共鳴スペクトル (400 Miz, CDCl3) Sppm: 1.47 (9H, s), 1.82-1.97(1H, m), 2.18-2.41 (1H, m), 3.1 40 9-3.34 (1H, m), 3.38-3.57 (2H, m), 3.66 (1H, dd, J =11.5, 6.3Hz), 4.11 (2H, s), 4.43-4.52 (1H, \mathbf{n}), 6. 66 (1H, br).MSスペクトル m/z: 263 (M+1)+. 元素分析 (C11H19N2O3C1として計算)

計算值: C, 50.29%; H, 7.29%; N, 10.66%; C1, 13.49 %.

38 実測値: C, 49.99%; H, 7.06%; N, 10.60%; C1, 13.50 ۲.

(2) 窒素気流中、参考例4-(1)で得られた化合 物(200mg)のメタノール(4ml)溶液にヨウ化 ナトリウム (342mg)と28%アンモニア水 (4m 1)を加え、室温で20時間撹拌した。反応混合物を減 圧濃縮し、水(20m1)、炭酸カリウム、塩化ナトリ ウムを加え塩化メチレンで抽出した(20m1で6 回)。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧 10 下濃縮して、油状の標記化合物(161mg)を得た。 スペクトルデータは、参考例3-(2)の化合物に一致 した。

(3) 窒素気流下、参考例4-(1)で得られた化合 物 (5.0g)のN,N-ジメチルホルムアミド (50 m1)溶液にアジ化ナトリウム(2.47g)を加え、 100℃で3時間撹拌した。反応混合物に酢酸エチル5 00m1を加え、10%食塩水(300m1で3回)、続 いて飽和食塩水(100ml)で洗浄し、有機層を無水 硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。残留物 20 をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (シリカゲル15 0g、ヘキサン: 酢酸エチル=1:1、続いて1:5) に 付し、アモルファス状の(S)-3-アジドアセチルア ミノー1ー t ープチルオキシカルボニルピロリジノン (4.47g)をアモルファスとして得た。

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CDCl3) Sppm: 1.47 (9H, s), 2.14-2.23 (1H, m), 3.12-3.33 (1H, m), 3. 36-3.51 (2H, m), 3.64 (1H, dd, J=11.5, 6.2 Hz), 4. 01 (2H, s), 4.41-4.51 (1H, m), 6.36 (1H, br). MSスペクトル ■/z: 270 (M+1)+

(4) 参考例4-(3)で得られた化合物(1.08 g) のメタノール (21.6ml) 溶液に20%水酸化 パラジウムー炭素(1.08g)を加え、常温、常圧で 3.5時間激しく撹拌しながら水素を吸収させた。触媒を 沪別し、沪液を減圧下濃縮して、油状の標記化合物(9 73mg)を得た。スペクトルデータは参考例3-(2)の化合物に一致した。

【0149】参考例 5

(1R, 5S, 6S) - 2 - [(2S, 4S) - 2 -[(3S)-3-[2-[2,3-ピス(4-ニトロベ ンジルオキシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミ ノ] ピロリジン-1-イルカルボニル] -1-メチルピ ロリジン-4-イルチオ]-6-[(1R)-1-ヒド ロキシエチル] -1-メチル-1-カルバペン-2-エ ムー3ーカルボン酸 4-ニトロベンジルエステル [0150]

【化20】

3-[2-[2, 3-ピス(4-ニトロベンジルオキシ カルボニル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロリジン -1-イルカルボニル]-1-メチルピロリジン(4. 3g) のN, N-ジメチルホルムアミド (86ml)溶 液にヒドラジン・酢酸(652mg)を加え室温で4時 間撹拌した。反応混合物に(1R, 5R, 6S) -6-[(1R)-1-ヒドロキシエチル]-1-メチル-2 ージフェニルホスホリルオキシー1ーカルバペンー2ー エム-3-カルボン酸 4-ニトロベンジルエステル (3.53g) とN, N-ジイソプロピルエチルアミン (1.34m1)を加え-30℃で3日間反応した。反 応混合物を1%炭酸水素ナトリウム水溶液に加え、析出 した粉末を沪取、水洗した。得られた粉末を、テトラヒ 20 ドロフラン: 酢酸エチル=3:7に溶解し、飽和炭酸水 素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸 マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮した。残留物をシ リカゲルカラムクロマトグラフィー (10%メタノール /酢酸エチル、続いて20%メタノール/酢酸エチル)で 精製、更に、テトラヒドロフランに溶解し、酢酸エチ ル:エーテル=1:1にて再沈殿することにより、淡黄*

*色粉末の標記化合物(4.02g)を得た。

【0151】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max cm ⁻¹: 3336, 1772, 1741, 1688, 1643, 1610, 1522, 144 10 7, 1378, 1347.

核磁気共鳴スペクトル (270 MHz, CDCl₃) δ ppm: 1.17-1.40 (6H, m), 1.64-2.40 (4H, m), 2.33 (3H, s), 2.47-2.80 (2H, m), 3.00-3.38 (3H, m), 3.46-3.83 (5H, m), 3.93-4.60 (5H, m), 5.12-5.54 (6H, m), 7.21 (1H, d, J=6.5 Hz), 7.46-7.70 (6H, m), 8.10-8.28 (6H, m), 8.80-9.10 (1H, br), 11.60 (1H, br)。

【0152】参考例 6

(1R, 5S, 6S) -6-[(1R) -1-ヒドロキシエチル] -1-メチル-2-[(2S, 4S) -2-[(3S) -3-[2-[3-(4-ニトロベンジルオキシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロリジン-1-イルカルボニル] -1-メチルピロリジン-4-イルチオ] -1-カルバペン-2-エム-3-カルボン酸 4-ニトロベンジルエステル

[0153]

【化21】

ルー2-[(35)-3-[2-[3-(4-ニトロベ ンジルオキシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミ ノ] ピロリジン-1-イルカルボニル] ピロリジン (1.00g)のメタノール(20m1)溶液に0℃で ナトリウムメチラート (98.3mg) を加え1時間撹 拌した。反応後、反応液に4N塩化水素/酢酸エチル (0.46ml)を加え減圧濃縮した。残留物はN,N ージメチルホルムアミド (10ml)溶液に溶解し、氷 冷下(1R, 5R, 6S)-6-[(1R)-1-ヒド ロキシエチル] -1-メチル-2-ジフェニルホスホリ ルオキシー1ーカルパペンー2-エムー3ーカルボン酸 4-二トロベンジルエステル (1.08g) とN, N ージイソプロピルエチルアミン(0.32ml)のN, N-ジメチルホルムアミド (10m1)溶液に加え、0 ℃で一夜反応した。反応終了後、反応混合物を1%炭酸 水素ナトリウム水溶液に加え析出した粉末を沪取、水 ※50

※洗、乾燥した。得られた粗粉末を、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(メタノール:酢酸エチル=1:3、続いてメタノール:酢酸エチル=1:2)に付し、標記化合物(975mg)を得た。

【0154】赤外線吸収スペクトル (KBr) レmax cm⁻¹:3384, 3113, 3080, 2970, 2875,2789, 1770, 1643, 140 609, 1522, 1450, 1379, 1346, 1322, 1287, 1209, 1181,1136, 1109.

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 1.08-2.22 (6H, m), 1.75-2.26 (6H, m), 2.44-2.76 (2H, m), 2.89-3.00 (1H; m), 3.03-3.15 (1H, m), 3.18-3.6 5 (6H, m), 3.68-3.90 (3H, m), 3.93-4.06 (1H, m), 4.13-4.35 (2H, m), 5.05-5.15 (2H, m), 5.30, 5.45 (each 1H, d, J=14.1), 7.58 (2H, dd, J=8.8, 2.7 Hz), 7.74 (2H, d, J=8.7 Hz), 8.18-8.33 (4H, m)。 【0155】参考例 7

(1R, 5S, 6S) -6-[(1R)-1-ヒドロキ

42

シエチル] -1-メチル-2-[(2S, 4S)-2-[(3S)-3-[2-[3-(4-ニトロベンジルオ キシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロリ ジン-1-イルカルボニル] -1-メチルピロリジン-* *4-イルチオ]-1-カルバペン-2-エム-3-カル ボン酸 4-ニトロベンジルエステル 【0156】 【化22】

(25, 45) -4-アセチルチオ-1-メチル-2-[(3S)-3-[2-[3-(4-ニトロベンジルオ キシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミノ] ピロリ ジン-1-イルカルボニル] ピロリジン (500mg) のエタノール (5 m l)溶液に4 N塩化水素/酢酸エチ ル (2.7m1)を加え50℃で3時間撹拌した。反応 混合物にエーテルを加え析出した粉末をデカンテーショ ンにより分離して、減圧乾燥した。得られた粉末をN, N-ジメチルホルムアミド (10ml) に溶解し、氷冷 下N、N-ジイソプロピルエチルアミン(0.63m 1)と(1R, 5R, 6S) -6-[(1R)-1-t ドロキシエチル] -1-メチル-2-ジフェニルホスホ リルオキシー1ーカルバペン-2-エム-3-カルボン 酸 4-二トロベンジルエステル (541mg)を加え 一夜反応した。反応終了後、反応混合物を1%炭酸水素 ナトリウム水溶液に加え析出した粉末を沪取、水洗、乾※ ※燥した。得られた粗粉末を、シリカゲルカラムクロマトグラフィー (30%メタノール/酢酸エチル、続いて50%メタノール/酢酸エチル)に付し、標記化合物 (446mg)を得た。このものは、赤外線吸収スペクトル及び核磁気共鳴スペクトルにおいて参考例6-(2)で得られた化合物に一致した。

【0157】参考例 8

(1R, 5S, 6S) -2-[(2S, 4S)-2-[(3S)-3-(2-グアニジノアセチルアミノ) ピ 20 ロリジン-1-イルカルボニル]-1-メチルピロリジ ン-4-イルチオ]-6-[(1R)-1-ヒドロキシ エチル]-1-メチル-1-カルバペン-2-エム-3 -カルボン酸・1/2エタノール 【0158】 【化23】

(1R, 5S, 6S) - 2 - [(2S, 4S) - 2 -[(3S)-3-[2-[2, 3-ビス(4-ニトロベ ンジルオキシカルボニル) グアニジノ] アセチルアミ ノ] ピロリジンー1ーイルカルボニル] ー1ーメチルピ ロリジン-4-イルチオ] -6-[(1R)-1-ヒド ロキシエチル] -1-メチル-1-カルバペン-2-エ ム-3-カルボン酸 4-ニトロベンジルエステル (1 0.00g)のテトラヒドフラン(250ml)-水 (150ml)溶液に7.5%パラジウムー炭素(5 3.1%水含有) (10.00g) を加え、35℃で撹 拌しながら水素を2時間吸収させた。触媒を沪別し、沪 液をエーテルで洗浄した後、メンブレンフィルターで沪 過してから、約50mlまで減圧濃縮した。残留物に、 エタノール100mlを加え、超音波にて刺激し結晶を 析出させた後、氷冷却下静置した。析出した結晶を沪 取、エタノール:水=2:1、エタノール、エーテルの 順で洗浄、乾燥し、無色結晶の標記化合物(3.30 g)を得た。

★【0159】融点 235-250℃(分解)。

【0160】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max cm ⁻¹: 3405, 3344, 3273, 3207, 2969,2883, 2795, 1760, 1673, 1644, 1591, 1553, 1452, 1415, 1381, 1370, 1341,1311, 1283, 1255.

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, D20) δppm: 1.15-1. 25 (4.5H, m), 1.30 (3H, d, J=6.4 Hz), 1.57-1.72 (140 H, m), 1.93-2.13 (1H, m), 2.15-2.35 (1H, m), 2.27, 2.29 (3H, s×2), 2.68-2.88 (2H, m), 3.08 (1H, d, J=10.7 Hz), 3.29-3.73 (7H, m), 3.75-3.93 (2H, m), 4.01 (3H, s), 4.16-4.31 (2H, m), 4.37-4.49 (1H, m).

元素分析 (C23H35N7O6S・1/2C2H6Oとして計算)

計算値: C, 51.41%; H, 6.83%; N, 17.49%; S, 5.72%. 実測値: C, 51.13%; H, 6.96%; N, 17.17%; S, 5.72%。 【0161】参考例 9

(1R, 5S, 6S) -2-[(2S, 4S) -2-★50 [(3S) -3-(2-グアニジノアセチルアミノ) ピ

-カルボン酸・1/2エタノール ロリジン-1-イルカルボニル]-1-メチルピロリジ ン-4-イルチオ]-6-[(1R)-1-ヒドロキシ [0162] エチル] -1-メチル-1-カルバペン-2-エム-3 【化24】

(1R, 5S, 6S) -6-[(1R) -1-tFロキ 10%ds) δ ppm: 1.28-1.46 (18H, m), 1.80-1.92 (1H, m), シエチル] -1-メチル-2-[(28, 48)-1-メチルー2ー[(3S)-3-[2-[3-(4-ニト ロベンジルオキシカルボニル) グアニジノ] アセチルア ミノ] ピロリジン-1-イルカルボニル] ピロリジンー 4-イルチオ] -1-カルバペン-2-エム-3-カル ボン酸 4-ニトロベンジルエステル (112mg)の テトラヒドフラン (2.2m1) -水(2.2m1)溶 液に7.5%パラジウムー炭素(53.1%水含有) (112mg)を加え、35℃で撹拌しながら水素を2 時間吸収させた。触媒を沪別し、沪液をエーテルで洗浄 20 した後、メンブレンフィルターで沪過してから、約1㎡ まで減圧濃縮した。残留物に、エタノール2m1を加 え、超音波にて刺激し結晶を析出させた後、氷冷却下、 静置した。析出した結晶を沪取、エタノール:水=2: 1、エタノール、エーテルの順で洗浄、乾燥し、無色粉 末結晶の標記化合物(45mg)を得た。このものは、 融点、赤外線吸収スペクトル、核磁気共鳴スペクトルお よび元素分析において参考例8で得られた化合物に一致 した。

【0163】参考例 10

ル) -4-ヒドロキシピロリジンカルボン酸・tert -ブチルエステル

[0164]

【化25】

(2S, 4R) - 1 - (tert - 7) + 5ル) -4-ヒドロキシピロリジンカルボン酸(1.31 g)と塩化ベンジルトリエチルアンモニウム (2.28) g)のN, N-ジメチルアセタミド(80ml)溶液に 臭化tert-ブチル(45.7m1)と炭酸カリウム (30.4g)を加え55℃で30時間撹拌した。反応 混合物に酢酸エチルを加え、水、10%食塩水、飽和食 塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減 圧濃縮して、無色粉末の標記目的化合物(2.36g) を得た。

【0165】核磁気共鳴スペクトル(400 MHz, DMSO- ※50 酸エチルを加え、水、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マ

2.02-2.16 (1H, m), 3.18-3.45 (2H, m), 4.02-4.11 (1H, m), 4.18-4.28 (1H, m).

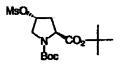
44

【0166】参考例 11

(2S, 4R)-1-(tert-ブトキシカルボニ ル) -4-メチルスルホニルオキシピロリジンカルボン 酸・tertープチルエステル

[0167]

【化26】



(1) 氷冷下、(2S, 4R)-1-(tert-ブ トキシカルボニル) -4-ヒドロキシピロリジンカルボ ン酸(2.31g)とトリエチルアミン(1.39m 1)の乾燥塩化メチレン (50m1)溶液にクロロトリ メチルシラン (1.27ml)を滴下した。 室温で1時 間撹拌した後、氷冷下トリエチルアミン(1.68m 1)を加えてから塩化メタンスルホニル(0.93m

30 1)を滴下し、室温で1時間撹拌した。反応混合物を減 圧濃縮した後、残留物に酢酸エチルを加えてから、水、 飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、減圧 濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィ (ベンゼン:アセトニトリル=9:1、ベンゼン:ア セトニトリル=8:2、続いてベンゼン:アセトニトリ ル=7:3)に付し、アモルファス状の(28,4R) -1-(tert-ブトキシカルボニル)-4-メチル スルホニルオキシピロリジンカルボン酸(2.22g) を得た。

40 【0168】核磁気共鳴スペクトル (270 MHz, CDCl₃) δ ppm: 1.33-1.58 (9H, m), 2.25-2.83 (2H, m), 3.07 (3H, s), 3.63-3.82 (2H, m), 4.37-4.60 (1H, m), 5. 20-5.33 (1H, m).

(2) 氷冷下。参考例11-(1)で得られた化合物 (1.30g)の乾燥アセトニトリル (50ml)溶液 に、ジーtert-ブチルジカーボナート(1.37 g)、トリエチルアミン(0.88m1)と4-ジメチ ルアミノピリジン(0.05g)を加え室温で一夜反応 した後、40℃で2時間撹拌したした。反応混合物に酢

グネシウムで乾燥した後、減圧濃縮した。残留物をシリ カゲルカラムクロマトグラフィー (シクロヘキサン:酢 酸エチル=65:35、続いてシクロヘキサン:酢酸エ チル=60:40)に付し、粉末状の標記目的化合物 (600mg)を得た。各種スペクトルデータは参考例 1-(1)の化合物に一致した。

【0169】参考例 12

(25, 45) - 4-アセチルチオ-1-メチル-2-ピロリジンカルボン酸

[0170] 【化27】



(1) 窒素気流中、水素化ナトリウム (60%鉱油懸 濁) (432mg)のN,N-ジメチルホルムアミド (25ml)懸濁液に、室温で(2S, 4R)-1-(tert-ブトキシカルボニル)-4-ヒドロキシピ 臭化アリル (1.96g)を滴下し、一夜反応した。反 応混合物に酢酸エチルを加え、希塩酸、飽和炭酸水素ナ トリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリ ウムで乾燥した後、減圧濃縮した。残留物をシリカゲル カラムクロマトグラフィー (ヘキサン:酢酸エチル= 3:1) に付し、無色油状の(2S, 4R)-1-(t ertーブトキシカルボニル) -4-ヒドロキシピロリ ジンカルボン酸・アリルエステル (2.86g)を得 た。

【 0 1 7 1 】 赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max c m^{-1} : 3443, 1749, 1702, 1680, 1547, 1479, 1455, 141 4, 1369, 1341.

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 1.4 2, 1.46 (9H, s×2), 1.78-1.90 (1H, **n**), 2.03-2.16 (1H, m), 2.22-2.38 (1H, m), 2.40-2.68 (2H, m), 4.3 8-4.74 (4H, m), 5.19-5.39 (2H, m), 5.86-5.98 (1H, m).

MSスペクトル m/z: 272 (M+1)+.

(2) 窒素気流中(2S, 4R)-1-(tert-ブトキシカルボニル) -4-ヒドロキシピロリジンカル 40 2, 1257. ボン酸(5.00g)とトリエチルアミン(3.34m 1)のN,N-ジメチルホルムアミド(25m1)溶液 に、臭化アリル (2.88g) を滴下し、60℃で3時 間撹拌した。反応混合物に酢酸エチルを加え、希塩酸、 飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、 無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。残留 物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチル=3:1)に付し、無色油状の(2S,4 R) -1-(tert-ブトキシカルボニル)-4-ヒ ドロキシピロリジンカルボン酸・アリルエステル (5.

46 00g)を得た。各種スペクトルデータは参考例12-

(1)の化合物に一致した。

(3) 窒素気流中、0℃で参考例12-(1)で得ら れた化合物(4.90g)とトリエチルアミン(2.2 0g)のテトラヒドロフラン(60m1)溶液に、塩化 メタンスルホニル (2.28g)を滴下し、0℃で30 分間、室温で2.5時間撹拌した。反応混合物に酢酸工 チルを加え、10%食塩水、飽和炭酸水素ナトリウム、 飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した 10 後、減圧濃縮した。シリカゲルカラムクロマトグラフィ ー (ヘキサン:酢酸エチル=2:1、続いてヘキサン: 酢酸エチル=1:1)に付し、無色油状の(28,4 チルスルホニルオキシピロリジンカルボン酸・アリルエ ステル(6.24g)を得た。

【 0 1 7 2 】 赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max c **■**¹: 1748, 1702, 1650, 1545, 1480, 1456, 1403, 136 7, 1286, 1260, 1233, 1174.

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CDC13) δ ppm: 1.4 ロリジンカルボン酸(2.50g)を少量ずつ加え、次に 20 2, 1.47 (9H, s×2), 2.22-2.82 (1H, m), 2.54-2.73 (1H, m), 3.06 (3H, s), 3.68-3.90 (2H, m), 4.37-4.7 3 (3H, \blacksquare), 5.17-5.38 (3H, \blacksquare), 5.83-5.97 (1H, \blacksquare). MSスペクトル m/z: 350 (M+1)+.

> (4) 窒素気流中、参考例12-(3)で得られた化 合物 (9.78g) のN, N-ジメチルアセトアミド (100ml)溶液に、チオ酢酸(3.62g)と炭酸セ シウム (7.75g)を加え、70℃で1.5時間撹拌 した。反応混合物に酢酸エチルを加え、20%食塩水、 飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、及び飽和食塩水の順で 30 洗浄した後、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥、減圧 濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィ ー (ヘキサン:酢酸エチル=5:1、ヘキサン:酢酸エ チル=4:1、ヘキサン:酢酸エチル=3:1、続いて ヘキサン:酢酸エチル=2:1)に附し、油状の(2) S, 4S) - 4 - P + f + J + 1 - (tert - J)キシカルボニル) ピロリジンカルボン酸・アリルエステ ル(8.02g)を得た。

【0173】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max c **1** 1751, 1702, 1650, 1479, 1455, 1397, 1368, 129 **1** 1751, 1702, 1650, 1479, 1455, 1397, 1368, 129

核磁気共鳴スペクトル (400 MHz, CDCl3) δ ppm: 1.4 1, 1.46 (9H, m), 1.92-2.05 (1H, m), 2.33 (3H, s), 2.65-2.84 (1H, \blacksquare), 3.27-3.40 (1H, \blacksquare), 3.90-4.05 (2 H, m), 4.28-4.44 (1H, m), 4.55-4.77 (2H, m), 5.20-5.40 (2H, m), 5.84-6.00 (1H, m).

MSスペクトル m/z: 330 (M+1)+.

(5) 窒素気流中、参考例12-(4)で得られた化 合物 (329mg) 、蟻酸 (189μ1) 、トリエチル アミン(701μ1)、トリフェニルホスフィン(58

50 mg) とテトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジ

ウム(0)(58mg)のテトラヒドロフラン(6ml)溶液を室温で一夜反応した。反応混合物に酢酸エチルを加え、希塩酸、10%食塩水、及び飽和食塩水の順で洗浄した後、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥、減圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=1:1、ヘキサン:酢酸エチル=1:2、ヘキサン:酢酸エチル=1:4、続いてヘキサン:酢酸エチル=1:5)に附し、粉末状の(2S,4S)-4-アセチルチオー1-(tert-ブトキシカルボニル)ピロリジンカルボン酸(279mg)を得た。

(6) 窒素気流中、参考例12-(4)で得られた化合物(329mg)、蟻酸(189μ1)、トリエチルアミン(701μ1)、トリフェニルホスフィン(92mg)と酢酸パラジウム(11mg)のテトラヒドロフラン(9.5ml)溶液を室温で5.5時間撹拌した。反20応混合物に酢酸エチルを加え、希塩酸、10%食塩水、及び飽和食塩水の順で洗浄した後、有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥、減圧濃縮した。残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル=1:1、ヘキサン:酢酸エチル=1:2、ヘキサン:酢酸エチル=1:1、ヘキサン:酢酸エチル=1:2、ヘキサン:酢酸エチル=1:5)に附し、粉末状の(2S,4S)-4-アセチルチオー1-(tert-ブトキシカルボニル)ピロリジンカルボン酸(257mg)を得た。スペクトルデータは、参考例12-(5)の化合物に一致した。30

(7) 窒素気流中、参考例12-(4)で得られた化 合物 (329mg)、蟻酸 (189µ1)、トリエチル アミン (701μ1)、トリフェニルホスフィン (92 mg)と塩化パラジウムトリフェニルホスフィン錯体 (35mg)のテトラヒドロフラン(9ml)溶液を室温 で一夜反応した。反応混合物に酢酸エチルを加え、希塩 酸、10%食塩水、及び飽和食塩水の順で洗浄した後、 有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥、減圧濃縮した。残 留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサ ン: 酢酸エチル=1:1、ヘキサン: 酢酸エチル=1:402、ヘキサン:酢酸エチル=1:4、続いてヘキサン: 酢酸エチル=1:5)に附し、粉末状の(2S,4S) -4-アセチルチオ-1-(tert-ブトキシカルボ ニル) ピロリジンカルボン酸 (199mg) を得た。ス ベクトルデータは、参考例12-(5)の化合物に一致 した。

(8) 参考例12-(5)で得られた化合物(250m (シリカゲル50g、ヘキサンg)の蟻酸(4ml)溶液を室温で4時間撹拌した。反 3)で精製し、油状物質として 応混合物を減圧濃縮して、粉末の(2S, 4S)-4- トキシカルボニルー3ーメタン アセチルチオピロリジンカルボン酸(218mg)を得 50 ジン(3.29 g)を得た。

た。

48

(9) 参考例12-(5)で得られた化合物(1.10g)の蟻酸(10ml)溶液を室温で4時間撹拌した後、反応混合物を減圧濃縮した。残留物に蟻酸(430μl)とホルマリン(1.3ml)を加え55℃で1.
 10 5時間撹拌した。反応混合物を減圧濃縮し、残留物をエチルエーテルで洗浄、デカンテーションにより分離して、逆相シリカゲルカラムクロマトグラフィー(ナカライテスク製コスモシール75C18-PREP)に附し、水にて溶出した画分を集め、粉末状の標記化合物(302mg)を得た。参考例1-(4)の化合物に一致した。

【0176】参考例 13

(S) -3-アミノ-1-tert-ブトキシカルボニ ルピロリジン

20 [0177]

【化28】



(1) (R) -3-ヒドロキシピロリジン・塩酸塩
(1.0g)をジクロロメタン(20m1)に溶解し、
氷冷下、トリエチルアミン(819 mg)およびジー
セertーブチルジカーボネート(1.77 g)を加
えた。反応液にジクロロメタン(300 m1)を加
30 え、有機層を重曹水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫
酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。得られた残渣
をカラムクロマトグラフィー(シリカゲル 50g、ヘキ
サン:酢酸エチル=1:1-1:4)で精製し、油状物質として(R)-1-tert-ブトキシカルボニル-3-ヒ
ドロキシピロリジン(1.51 g)を得た。
【0178】核磁気共鳴スペクトル(400MHz, CDCl₃)
δ ppm: 1.46 (9H, s), 1.93-2.02 (2H, m), 3.27-3.56
(4H, m), 4.42-4.49 (1H, m).

MSスペクトル m/z: 187 (M+).

(2) 参考例13-(1)で得られた化合物(2.33g)をジクロロメタン(45 ml)に溶解し、氷冷下、トリエチルアミン(1.39g)および塩化メタンスルホニル(1.57g)を加えた。反応液に酢酸エチル(150ml)を加え、有機層を重曹水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。得られた残渣をカラムクロマトグラフィー(シリカゲル50g、ヘキサン:酢酸エチル=2:1-1:3)で精製し、油状物質として(R)-1-tert-ブトキシカルボニルー3-メタンスルホニルオキシピロリジン(3.20g)を得た

【0179】赤外線吸収スペクトル (neat) νmax cm⁻¹: 2978, 1695, 1409, 1364, 1171,1118, 958, 902. 核磁気共鳴スペクトル (400MHz, CDCl₃) δppm: 1.47 (9H, s), 2.08-2.20 (1H, m), 2.20-2.35 (1H, m), 3.0 5 (3H, s), 3.41-3.73 (4H, m), 5.24-5.28 (1H, m). MSスペクトル m/z: 266(M+1)⁺.

(3) 窒素気流下、参考例13-(2)で得られた化合物(1.0g)のDMF溶液(20m1)にアジ化ナトリウム(270mg)を加え、100℃で2.5時間撹拌した。反応液に酢酸エチル(300m1)を加え、有機層を重曹水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。得られた残渣をカラムクロマトグラフィー(シリカゲル50g、ヘキサン:酢酸エチル=5:1-1:1)で精製し、油状物質として(S)-3-アジド-1-tert-ブトキシカルボニルピロリジン(734mg)を得た。

【0180】赤外線吸収スペクトル (neat) レmax cm⁻¹: 2978, 2104, 1699, 1405, 1168,1114.

核磁気共鳴スペクトル (400MHz, CDCl3) δ ppm: 1.47 5 ml)溶液を、氷冷下、滴下により加え、同温で2 (9H, s), 1.96-2.20(2H, m), 3.13-3.28 (4H, m), 4. 20 間、室温で3時間撹拌した後、室温で一夜放置した。 10-4.18 (1H, m). 【0184】反応液に、氷冷下、クエン酸水溶液を加

MSスペクトル m/z: 213 (M+1)+.

(4) 窒素気流下、参考例13-(3)で得られた化合物(100 mg)のアセトニトリル溶液(2 m1)にトリフェニルホスフィン(130 mg)を加え、70℃で1.5時間撹拌した後、硫酸ナトリウム・10水和物(159 mg)を加え3.5時間撹拌した。反応液をろ過した後、ろ液を濃縮乾固した。水(20m1)と1N塩酸(0.71 ml)を加え、水層をジクロロメタンで洗浄した後、水層に炭酸カリウム、塩化ナトリウムをくわえ、ジクロロメタンで抽出した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮することにより、無色粉末として(S)-3-アミノ-1-tert-ブトキシカルボニルピロリジン(78mg)を得た。

【 O 1 8 1 】赤外線吸収スペクトル(KBr)レmax cm ⁻¹: 2976, 1695, 1416, 1175.

核磁気共鳴スペクトル (400MHz, D₂0) δ ppm: 1.47 (9 H, s), 2.04-2.16 (1H, m), 2.30-2.42 (1H, m), 3.40-3.60 (1H, m), 3.62-3.79 (1H, m), 3.95-4.03(1H, m). MSスペクトル m/z: 187 (M+1)⁺.

(5)参考例13-(3)で得られた化合物(200 mg)のメタノール溶液(4 m1)に10%パラジウムー炭素触媒(200 mg)を加え、水素気流下、室温で5時間撹拌した。反応液をろ過した後、ろ液を濃縮し、得られた残渣をカラムクロマトグラフィー(逆相用シリカゲル 10g、水:アセトニトリル=4:1-1:1)で精製し、無色粉末として(S)-3-アミノ-1-tert-ブトキシカルボニルピロリジン(118 mg)を得た。

【0182】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max cm

⁻¹: 2976, 1695, 1416, 1175.

核磁気共鳴スペクトル (400MHz, D₂0) δ ppm: 1.47 (9 H, s), 2.04-2.16 (1H, m), 2.30-2.42 (1H, m), 3.40-3.60 (1H, m), 3.62-3.79 (1H, m), 3.95-4.03(1H, m). MSスペクトル m/z: 187 (M+1)+.

参考例 14

(3S)-3-tert*ーブチルオキシカルボニル*アミ ノピロリジン

[0183]

10 【化29】



(1) 塩化カルシウム(2.2g)を乾燥エタノール(25ml)に溶解し、氷冷下、水素化ほう素ナトリウム(0.57g)を加え、同温で1時間撹拌した。次いで、L-N-tert-ブチルオキシカルボニルアスパラギン酸 ジメチル(2.6g)の乾燥エタノール(25ml)溶液を、氷冷下、滴下により加え、同温で2時間、空温で3時間撹拌した後、室温で一夜放置した。

【0184】反応液に、氷冷下、クエン酸水溶液を加え、pHを4に調整し、次いで、同温にて炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、pHを6に調整した後、減圧濃縮によりエタノールを溜去した。残った水層に食塩を加え、酢酸エチルで2回抽出し、有機層を併せて無水硫酸マグネシウムで脱水、減圧濃縮した。

【0185】残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(富士シリシア化学製シリカゲルFL-100B

酸(0.71 ml)を加え、水層をジクロロメタンで (100g)に附し、酢酸エチル:メタノール(95: 洗浄した後、水層に炭酸カリウム、塩化ナトリウムをく 30 5)にて溶出した画分より、油状の(25)-2-te わえ、ジクロロメタンで抽出した。有機層を無水硫酸ナ rtーブチルオキシカルボニルアミノー1,4ーブタン トリウムで乾燥後、減圧下濃縮することにより、無色粉 ジオール(2.0g)を得た。

【0186】赤外線吸収スペクトル(KBr) ν max cm⁻¹: 3348, 2977, 2936, 1687, 1529, 1368, 1251, 1172, 1055.

核磁気共鳴スペクトル(400MHz, CDCl₃) δppm: 1.45 (9 H, s), 1.54-1.65 (1H, m), 1.77-1.88 (1H, m), 2.65-3.10 (1H, br), 3.20-3.55 (1H, br), 3.63-3.93 (5H, m), 5.09-5.10 (1H, m).

40 MSスペクトルm/e: 206 (M+1)+.

(2) 参考例14-(1)で得られた化合物(2.0g)を、乾燥塩化メチレン(40ml)に溶解し、氷冷下、トリエチルアミン(4.2ml)及び、塩化メタンスルホニル(1.9ml)を滴下により加え、同温で1時間、室温で30分間撹拌した。

【0187】反応液を酢酸エチルで希釈し、炭酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水の順で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムで脱水、減圧濃縮した。

【0188】残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ

50 ー (富士シリシア化学製シリカゲルFL-100B

(100g) に附し、塩化メチレン:シクロヘキサン: 酢酸エチル (50:20:30) にて溶出した画分よ り、粉末状の25) -2-tert-ブチルオキシカル ボニルアミノー1, 4ージメタンスルホンオキシブタン (2.8g)を得た。

【0189】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max cm-1: 3387, 1687, 1514, 1347, 1172.

核磁気共鳴スペクトル (400MHz, CDCl₃) δ ppm: 1.45 (9H, s), 1.93-2.11 (2H, m), 2.87 (3H, s), 2.88 (3 H, s), 4.04-4.11 (1H, \blacksquare), 4.25-4.40 (4H, \blacksquare), 4.79-4.81 (1H, ■).

MSスペクトル m/e: 362 (M+1)+.

(3) 参考例14-(2)で得られた化合物(0.5 g)をアセトニトリル (5m1) に溶解し、28%-ア ンモニア水 (5m1) 及び炭酸ナトリウム (1.5g) を加え、室温で2日間撹拌した後、反応液を沪過し、沪 液を減圧濃縮、減圧乾燥した。

【0190】残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ - (富士シリシア化学製シリカゲルFL-100B 50~0:100) にて溶出した画分より、アモルファ ス状の標記目的化合物(0.07g)を得た。

【0191】核磁気共鳴スペクトル (400Mbz, CDCl3) δ ppm: 1.45 (9H, s), 1.53-1.68 (1H, m), 2.03-2.18 (1H, m), 2.27-2.46 (1H, br), 2.73-2.82 (1H, m), 2. 87-2.96(1H, m), 3.00-3.15(2H, m), 4.01-4.21(1H, b)r), 4.72-4.93 (1H, br).

MSスペクトルm/e: 187 (M+1)+.

参考例 15

(S) - 1 - ベンゾイル - 3 - tert - ブトキシカルボニルアミノピロリジン

[0192]

【化30】



(1) 窒素気流下、N-(tert-ブトキシカルボ ニル) -L-アスパラギン (4.64 g) のアセトニ トリル溶液 (50m1) にトリエチルアミン (6.68 g) 塩化メタンスルホニル (2.52 g) を加え、-2 0℃で30分撹拌した。さらに-10℃でクロロギ酸エチル (4.77 g)を加え、30分損拌後、メタノール (13ml)、トリエチルアミン(4.05 mg)を 加えた。室温まで昇温後、室温で30分撹拌し、反応液 に酢酸エチル(150m1)を加えた。有機層を重曹 水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾 燥後、減圧下濃縮した。得られた残渣をカラムクロマト

=2:1-1:2)で精製し、無色粉末として(S)-2tert-ブトキシカルボニルアミノー3-シアノプロ ピオン酸メチル (4.19g)を得、さらにヘキサン-酢酸エチルより再結晶することにより無色結晶(2.6 4g)を得た。

52

【0193】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max cm-1: 3360, 2995, 1737, 1676, 1522, 1352, 1298, 1235, 1 205, 1160,

核磁気共鳴スペクトル (400MHz, CDCl₃) δ ppm: 1.46 10 (9H, s), 2.29 (1H, dd, J = 16.8, 4.4 Hz), 3.16 (1) H, dd, J = 16.8, 5.3 Hz), 3.85 (3H, s), 4.48-4.58 (1H, n), 5.39-5.52 (1H, n).

MSスペクトル m/z: 229 (M+1)+.

旋光度 [α]₀²⁵ +41.2° (c 1.13, CHCl₃) 融点 80-81℃

(2) 窒素気流下、塩化カルシウム (139 mg) 及び水素化ホウ素ナトリウム (47 mg)のエタノー ル溶液 (5 m l) に、参考例 15-(1) で得られた化 合物 (285 mg) を加え、0℃で1時間、室温で30 (15g)に附し、塩化メチレン:メタノール(50: 20 分撹拌した。反応液に、クエン酸水溶液を加えた後、重 曹水で中和し酢酸エチル(50m1)を加え抽出した。 有機層を重曹水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナ トリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。得られた残渣をカ ラムクロマトグラフィー (シリカゲル 10g、ヘキサ ン:酢酸エチル=1:2-1:6)で精製し、無色油状物質 として(S)-2-tert-ブトキシカルボニルアミ ノー3ーシアノプロパノール(225 mg)を得た。 【0194】赤外線吸収スペクトル (neat) ν max cm⁻¹ : 3432, 3351, 2980, 1693, 1525, 1369, 1253, 1170, 30 1064, 916, 735.

> 核磁気共鳴スペクトル (400MHz, CDCl₃) Sppm: 1.46 (9H, s), 2.19 (1H, t, J = 5.1 Hz), 2.73 (2H, d, J)= 5.9 Hz), 3.67-3.89 (2H, \blacksquare), 3.90-4.10 (1H, \blacksquare), 5.04 (1H, br d, J = 7.3 Hz).

MSスペクトル ■/z: 201 (M+1)+.

(3) 窒素気流下、参考例15-(2)で得られた化 合物 (1.09 g) のテトラヒドロフラン溶液 (20 m1) に、トリエチルアミン (661 mg) 塩化メタ ンスルホニル (686 mg) を加え、0℃で1時間、室 40 温で1時間撹拌した。酢酸エチル(150ml)を加え 抽出し、有機層を希塩酸、重曹水、飽和食塩水で順次洗 浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。 得られた残渣をカラムクロマトグラフィー(シリカゲル 50g、ヘキサン:酢酸エチル=2:1-1:6)で精製 し、(S) -2-tert-ブトキシカルボニルアミノ -3-シアノ-1-メタンスルホニルオキシプロパン (1.38 g)を得、さらにヘキサン一酢酸エチルよ り再結晶することにより無色結晶(1.15g)を得 た。

グラフィー(シリカゲル 150g、ヘキサン:酢酸エチル 50 【0195】赤外線吸収スペクトル(KBr)νmax cm

⁻¹: 3353, 2983, 1684, 1530, 1352,1290, 1171, 100 5. 972. 834.

核磁気共鳴スペクトル (400MHz, CDCl3) δ ppm): 1.46 (9H, s), 2.76 (2H, d, J = 6.6 Hz), 3.11 (3H, s), 4.17-4.28 (1H, m), 4.34 (1H, dd, J = 10.3, 3.7 Hz), 4.40 (1H, dd, J = 10.3, 4.4 Hz), 4.95-5.07 (1H, **m**).

MSスペクトル m/z: 279 (H+1)+ 旋光度 {α}₀²⁵ +8.83° (c 0.68, CHCl₃) 融点 110-111℃

(4) 窒素気流下、参考例15-(3)で得られた化 合物 (1.39 g) のDMF溶液 (15ml) にアジ化ナ トリウム (598 mg) を加え、50°Cで5時間撹拌した 後、反応液に酢酸エチル150mlを加え、重曹水、飽和食 塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧 下濃縮した。得られた残渣をカラムクロマトグラフィー (シリカゲル 150g、ヘキサン:酢酸エチル=2:1-1:1) で精製し、油状物質として(S)-1-アジドー 2-tert-ブトキシカルボニルアミノ-3-シアノ プロパン(1.09 g)を得た。

【0196】赤外線吸収スペクトル (neat) cm⁻¹:333 9, 2981, 2108, 1699, 1522, 1369, 1253, 1169. 核磁気共鳴スペクトル (400MHz, CDCl3) Sppm: 1.46 (9H, s), 2.60-2.79 (2H, m) 3.55 (2H, dd, J = 12.5,5.9 Hz), 3.16 (1H, dd, J = 12.5, 4.4 Hz), 3.97-4.1

2 (1H, m), 4.76-4.93 (1H, br). MSスペクトル m/z: 226 (M+1)+

旋光度 [α]₀25 +2.94° (c 0.66, CHCl₃)

(5) 参考例15-(4)で得られた化合物(56 mg)をメタノール (2m1)及び水 (225 μ1)に 30 融点 80-81℃ 溶解し、パロジウム-炭素触媒(51 mg)を加え、室 温、水素気流下にて7時間反応させた。触媒をろ過した 後、ろ液を濃縮した、。残渣をテトラヒドロフランに溶 解し、トリエチルアミン (101 mg) 塩化ベンゾイ ル (105 mg)を加えた。反応液に酢酸エチルを加 え、有機層を重曹水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫 酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。得られた残渣 をカラムクロマトグラフィー (シリカゲル 5g、ヘキサ ン: 酢酸エチル=1:2-1:6) で精製し、無色油状物質 として標記目的化合物(S)-1-ベンゾイルー3-t ertーブトキシカルボニルアミノピロリジン(43 mg)を得た。

【 0 1 9 7 】 赤外線吸収スペクトル (neat) ν max cm⁻¹ : 3300, 2977, 1711, 1622, 1528, 1429, 1171. 核磁気共鳴スペクトル(400MHz, CDCl3)δppm: 1.41, 1.47 (9H, s x2), 1.82-1.94 (1H, ■), 2.08-2.30 (1H, m), 3.25-3.96 (4H, m), 4.08-4.38 (1H, m), 4.54-4.7 3 (1H, **m**), 7.39–7.57 (5H, **m**). MSスペクトル m/z: 279 (叶)

参考例 16

(S) -1-ベンゾイル-3-tert-ブトキシカル ボニルアミノピロリジン

[0198] 【化31】



(1) 窒素気流下、参考例14-(2)で得られた化 合物 (91 mg) のDMF溶液 (3ml) にアジ化ナトリ ウム (36 mg) を加え、氷冷下で23時間撹拌した 後、室温で5時間攪拌した。反応液に酢酸エチル(20 ml)を加え、重曹水、飽和食塩水で順次洗浄し、無 水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。得られた 残渣をカラムクロマトグラフィー (シリカゲル 5g、へ キサン:酢酸エチル:ジクロロメタン=1:1:1-1: 3:1) で精製し、無色結晶として(S)-4-アジドー 2-tert-ブトキシカルポニルアミノ-1-メタン 20 スルホニルオキシブタン (54 mg)を得た。

【0199】赤外線吸収スペクトル (neat) ν max c m⁻¹ : 3355, 2940, 2109, 1689, 1527, 1354, 1184, 977. 核磁気共鳴スペクトル (400MHz, CDCl3) Sppm: 1.45 (9H, s), 1.71-1.92 (2H, m) 3.05 (3H, s), 3.39-3.51 (2H, m), 3.95-4.05 (1H, m), 4.24 (1H, dd, J = 10.3, 3.7 Hz), 4.30 (1H, dd, J = 10.3, 5.1 Hz), 4.73(1H, br d, J = 8.1 Hz).

MSスペクトル m/z:309 (M+1)+

旋光度 [α]p²⁵ -28.1° (c 1.08, CHCl₃)

(2) 参考例16-(1)で得られた化合物(77 mg)をメタノール(2ml)に溶解し、10%パラジウ ム-炭素触媒 (54 mg) を加え、室温、水素気流下に て1時間反応させた。触媒をろ過し、ろ液を50℃で10 時間加熱した後、濃縮した、。残渣をテトラヒドロフラ ンに溶解し、トリエチルアミン (101mg) 塩化ベン ゾイル(105 mg)を加えた。 反応液に酢酸エチル を加え、有機層を重曹水、飽和食塩水で順次洗浄し、無 水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮して、標記目的 40 化合物 (67 mg) を得た。スペクトルデータは参考 例15-(5)の化合物に一致した。

参考例 17

(S)-3-アミノピロリジン・2塩酸塩 [0200]

【化32】



(1) 窒素気流下、L-アスパラギン(6.00

g) のアセトニトリルー水 (1:1) 混合溶媒 (80m 1) に溶解し、トリエチルアミン(20.2 g) を加 え、室温でで30分撹拌した。氷冷下、クロロギ酸メチル (15.1 g)を加え、1.5時間攪拌した。反応液を濃 縮した後、残渣に酢酸エチル、希塩酸を加え抽出し、有 機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮するこ とにより、油状物質として(S)-3-シアノ-2-メ トキシカルボニルアミノプロピオン酸(6.11g)を 得た。

【0201】赤外線吸収スペクトル (neat) ν max cm⁻¹ 10 :3345, 2962, 1724, 1534, 1441, 1265, 1066. 核磁気共鳴スペクトル(400MHz, CDC13) δ ppm : 3.00 (1H, dd, J = 16.8, 4.4 Hz), 3.16 (1H, dd, J = 16.

8, 5.1 Hz), 3.74 (3H, s), 4.55-4.65 (1H, m), 5.72 (1H, br d, J = 5.9 Hz).

MSスペクトル m/z: 173 (計1)+

(2) 窒素気流下、参考例17-(1)で得られた化 合物(6.11 g)をDMF (60m1)に溶解し、炭 酸セシウム (9.25 g) を加え、50°Cで1時間撹拌し た。さらに氷冷下、ヨウ化メチル(8.57 g)を加 え、室温で1.5時間、40℃で2時間攪拌した。反応液に酢 酸エチル(600 ml) を加え、有機層を10%チオ硫 酸ナトリウム水溶液、重曹水、飽和食塩水で順次洗浄 し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。得 られた残渣をカラムクロマトグラフィー (シリカゲル 3 00g、ヘキサン:酢酸エチル=1:1-1:3)で精製し、 無色結晶として(S)-3-シアノ-2-メトキシカル ボニルアミノプロピオン酸メチル (4.58 g) を得 た。

【0202】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max cm ⁻¹ :3326, 2954, 1740, 1690, 1539, 1357, 1296, 107 0, 1031.

核磁気共鳴スペクトル(400MHz, CDC13) δ ppm : 2.95 (1H, dd, J = 17.2, 4.8 Hz), 3.05 (1H, dd, J = 17.2, 5.5 Hz), 3.73 (3H, s), 3.86 (3H, s), 4.52-4.65 (1H, n), 5.59-5.81 (1H, br s).

MSスペクトル ■/z: 187 (M+1)+

(3) 窒素気流下、塩化カルシウム (2.49 g) 及 び水素化ホウ素ナトリウム (1.02 g) のエタノー ル溶液 (50 ml) に、参考例17-(2) で得られ た化合物 (4.18 g) を加え、0℃で1時間、室温で 30分撹拌した。反応液に、クエン酸水溶液を加えた 後、重曹水で中和し酢酸エチル(50ml)を加え抽出 した。有機層を重曹水、飽和食塩水で順次洗浄し、無水 硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。得られた残 渣をカラムクロマトグラフィー (シリカゲル 150g、ヘ キサン:酢酸エチル=1:2-1:6)で精製し、無色油状 物質として (S) -3-シアノ-2-メトキシカルボニ ルアミノプロパノール(2.47g)を得た。

56

: 3329, 3072, 1706, 1539, 1266, 1070. 核磁気共鳴スペクトル (400MHz, CDCl₃) δ ppm : 2.50 (1H, br s), 2.75 (1H, d, J = 6.6 Hz), 3.71 (3H, s), 3.72-3.90 (2H, m), 3.96-4.07 (1H, m), 5.38 (1 H. br s).

MSスペクトル m/z: 159 (M+1)+

(4) 窒素気流下、参考例17-(3)で得られた化 合物 (2.40 g) のテトラヒドロフラン溶液 (60 ml) に、トリエチルアミン (1.84 g) 塩化メタ ンスルホニル (1.91 g) を加え、0℃で1時間、室 温で1時間撹拌した。酢酸エチル(600 ml)を加え 抽出し、有機層を希塩酸、重曹水、飽和食塩水で順次洗 浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。 得られた残渣をカラムクロマトグラフィー(シリカゲル 150g、ヘキサン:酢酸エチル=1:1-1:5)で精製 し、無色油状物質として(S)-3-シアノ-1-メタ ンスルホニルオキシー2-メトキシカルボニルアミノブ ロパン(3.53 g)を得た。

【0204】赤外線吸収スペクトル (neat) ν max cm⁻¹ : 3331, 2960, 1723, 1536, 1356, 1251, 1177, 970. 核磁気共鳴スペクトル (400MHz, CDCl₃) δ ppm: 2.78 (2H, d, J = 6.6 Hz), 3.11 (3H, s), 3.72 (3H, s), 4.22-4.46 (1H, m), 5.29-5.38 (1H, br s).

MSスペクトル w/z: 237 (M+1)+

(5) 参考例17-(4) で得られた化合物 (59 m g)をメタノール(2 ml)に溶解し、10%塩酸-メタ ノール(0.46 m1)、5%ロジウム-炭素触媒(10 2 mg)を加え、室温、水素気流下にて20時間反応さ せた。触媒をろ過し、ろ液に炭酸セシウム(81mg) 30 を加え、2日間撹拌した。反応液を10%塩酸-メタノー ルで弱酸性にした後、濃縮した。残渣をアセトニトリル に溶解し、トリエチルアミン (101 mg)、塩化ベ ンゾイル(105 mg)を加えた。反応液に酢酸エチ ルを加え、有機層を重曹水、飽和食塩水で順次洗浄し、 無水硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧下濃縮した。得られ た残渣をカラムクロマトグラフィー (シリカゲル 5g、 酢酸エチル:メタノール=10:0-9:1)で精製し、無 色油状物質として(S)-1-ベンゾイル-3-メトキ シカルボニルアミノピロリジン (46 mg)を得た。 【 0 2 0 5 】 赤外線吸収スペクトル (neat) ν max cm⁻¹

核磁気共鳴スペクトル (400Mlz, CDCl3) Sppm: 1.83-1.97 (1H, m), 2:11-2.33 (1H, m), 3.27-3.96 (4H, m), 3.55, 3.64 (3H, s x2), 4.17-4.42 (1H, m), 4.75 -4.98 (1H, m), 7.37-7.56 (5H, m).

: 3256, 1723, 1605, 1545, 1449, 1435, 1285, 1253,

MSスペクトル m/z: 248 (M*)

1099.

(6) 参考例17-(5)で得られた化合物(124 mg)を2 M NaOH水溶液(2.5 ml)に溶解し、3. 【0203】赤外線吸収スペクトル (neat) ν max cm⁻¹ 50 5時間還流した。反応液を10%塩酸-メタノールでpH 2程

度の酸性にした後、濃縮した。残渣にエタノールを加 え、不溶物を沪過後、ろ液を減圧下濃縮することによ り、吸湿性の無色粉末として標記目的化合物(28 m g)を得た。

【0206】核磁気共鳴スペクトル(400Mlz, D20) δp pm : 2.13-2.27 (1H, m), 2.52-2.63 (1H, m), 3.46 (1 H. dd, J = 13.2, 5.9 Hz), 3.47-3.65 (2H, \blacksquare), 3.82(1H, dd, J = 13.2, 8.1 Hz), 4.14-4.23 (1H, m).参考例18

キシカルボニルアミノメチルカルボニル) アミノピロリ ジン

[0207]

【化33】

リシン (3.5g) を乾燥テトラヒドロフラン (70m 20 1) に溶解し、氷冷下、N, N-ジイソプロピルエチル アミン (3.8ml)及び、塩化ピバロイル (2.7m 1)を加え、同温で1時間撹拌した。次いで、氷冷下、 N, N-ジイソプロピルエチルアミン(4.2m1)及 び、L-アスパラギン酸 ジメチル (4.3g)を加 え、同温で2時間後、室温で一夜放置した。

【0208】反応液を酢酸エチルで希釈し、水、飽和食 塩水の順で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウム で脱水、減圧濃縮した。

【0209】残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ 30 - (富士シリシア化学製シリカゲルFL-100B (300g) に附し、シクロヘキサン: 酢酸エチル (4 0:60~0:100) にて溶出した画分より、油状の L-(N-tert-ブチルオキシカルボニルアミノメ チルカルボニル) アスパラギン酸 ジメチル (5.5 g)を得た。

【0210】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max c **n**⁻¹: 3338, 1740, 1682, 1523, 1439,1369, 1282, 125 0, 1221, 1172.

核磁気共鳴スペクトル (400Mlz, CDCl3) δppm: 1.46 (9 40 H, s), 2.83-2.88 (1H, m), 3.02-3.07 (1H, m), 3.69-3.95 (2H. m), 3.76 (3H, s), 3.84 (3H, s), 4.85-4.90 (1H, m), 5.17 (1H, br), 7.04-7.06 (1H, m).

MSスペクトル m/e: 319(M+1)*

(2) 塩化カルシウム(5.4g)を乾燥エタノール (80ml) に溶解し、氷冷下、水素化ほう素ナトリウ ム(1.4g)を加え、同温で30分間撹拌した。次い で、参考例18-(1)で得られた化合物(7.8g) の乾燥エタノール (80m1)溶液を、氷冷下、滴下に より加え、同温で30分間、室温で2時間撹拌した。

【0211】反応液に、氷冷下、クエン酸水溶液を加 え、pHを4に調整し、次いで、同温にて炭酸水素ナト リウム水溶液を加え、pHを6に調整した後、減圧濃縮 によりエタノールを溜去した。残った水層に塩化アンモ ニウムを加え、酢酸エチルで3回抽出し、有機層を併せ て無水硫酸マグネシウムで脱水、減圧濃縮した。

58

【0212】残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ ー (富士シリシア化学製シリカゲルFL-100B (300g)) に附し、塩化メチレン: 酢酸エチル:メ (3S) -1-アリル-3-(N-tert-ブチルオ 10 タノール(50:40:10)にて溶出した画分より、 アモルファス状の (2S) -2- (N-tert-ブチ ルオキシカルボニルアミノメチルカルボニル) アミノー 1,4-ブタンジオール(5.7g)を得た。

> 【0213】赤外線吸収スペクトル(KBr) ν max cm⁻¹: 3321, 1697, 1662, 1537, 1369, 1284, 1252, 1170, 10

核磁気共鳴スペクトル (400MHz, DMSO-ds) δ ppm: 1.30 -1.54 (1H, m), 1.38(9H, s), 1.64-1.72 (1H, m), 3.2 6-3.56 (6H, m), 3.74-3.82 (1H, m), 4.36-4.38 (1H, \mathbf{m}), 4.64-4.67 (1H, \mathbf{m}), 6.87-6.90 (1H, \mathbf{m}), 7.45-7.4 7 (1H, m).

MSスペクトル m/e: 263 (M+1)*

(3) 参考例18-(2)で得られた化合物(5.5 g) を、乾燥N, N-ジメチルアセトアミド (80m 1) に溶解し、氷冷下、トリエチルアミン(8.8m 1)及び、塩化メタンスルホニル (4.1m1)を滴下 により加え、同温で1時間撹拌した。

【0214】反応液を酢酸エチルで希釈し、10%-食 塩水、炭酸水素ナトリウム水溶液、水、飽和食塩水の順 で洗浄した後、有機層を無水硫酸マグネシウムで脱水、 減圧濃縮した。

【0215】残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィ - (富士シリシア化学製シリカゲルFL-100B (300g)) に附し、シクロヘキサン: 酢酸エチル (10:90~0:100) にて溶出した画分より、ア モルファス状の (2S) -2- (N-tert-ブチル オキシカルボニルアミノメチルカルボニル) アミノー 1.4-ジメタンスルホンオキシブタン(6.0g)を 得た。

【0216】赤外線吸収スペクトル (KBr) ν max cm⁻¹: 3370, 1703, 1523, 1352, 1191, 1174.

核磁気共鳴スペクトル(400MHz, CDCl3)δppm: 1.45 (9H, s), 2.00-2.14 (1H, m), 2.21-2.37 (1H, m), 2.7 9-3.23 (6H, m), 3.80-3.81 (1H, m), 4.25-4.74 (6H, m).

MSスペクトル m/e: 419 (M+1)*

(4) 参考例18-(3)で得られた化合物(0.5 g)を乾燥塩化メチレン(20m1)に溶解し、アリル アミン(0.2m1)及び炭酸ナトリウム(1.3g)

50 を加え、室温で2日間撹拌した後、反応液を沪過し、沪

液を減圧濃縮、減圧乾燥した。

【0217】残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(富士シリシア化学製シリカゲルFL-100B(30g))に附し、酢酸エチル:メタノール(70:30)にて溶出した画分より、油状の標記目的化合物を得た。

MSスペクトル m/e: 284 (M+1)+

参考例 19

(2S, 4S) -4-アセチルチオ-1-メチル-2-ピロリジンカルボン酸

[0219]

【化34】

(1) Lーヒドロキシプロリン (10g)を水 (50 m1) に溶解し、酢酸 (85 m1) 及び、37% ホルムアルデヒド水溶液 (6.57 m1)を加えた。反応液 に酸化白金 (865 mg)を加え、水素雰囲気下、30℃で、5.5時間反応させた。反応液を逆相カラムに 通すことにより酸化白金を除去し、ろ液を減圧下濃縮した。残渣にアセトンを加え、析出した粉末をデ取することにより、無色粉末として (2S,4R) -4-ヒドロキシー1-メチル-2-ピロリジンカルボン酸 (10.3 g)を得た。

【0220】核磁気共鳴スペクトル (400MHz, D₂0) δp pm: 2.19-2.29 (1H, m), 2.45-2.56 (1H, m), 3.18 (1 H, d, J = 12.5 Hz), 3.95 (1H, dd, J = 12.5, 4.8 Hz), 4.18 (1H, dd, J = 11.0, 7.3Hz), 4.60-4.69 (1H, m).

MSスペクトル m/z: 145 (Mt)

(2) 参考例19-(1)で得られた化合物(2.0g)をアリルアルコール(24.0g)に懸濁させ、 氷冷下ジメチルホルムアミド(1.01g)及び塩化 チオニル(4.89g)を順次加え、8時間湿流した。反応液を減圧下濃縮し、残渣に飽和食塩水及び重曹 水を加え、ジクロロメタンで抽出した。有機層を無水硫 酸ナトリウムで乾燥し、減圧下濃縮することにより、無 色油状物質として(2S,4R)-4-ヒドロキシー1 ーメチルー2-ピロリジンカルボン酸アリル(2.56g)を得た。

【0221】赤外線吸収スペクトル (neat) レmax cm⁻¹: 3388, 2948, 1744, 1669, 1455,1273, 1194, 1090, 996, 931.

核磁気共鳴スペクトル (400MHz, CDCl₃) δ ppm: 1.83 (1H, br s), 2.05-2.12 (1H, m), 2.22-2.31 (1H, m), 2.39 (1H, dd, J = 10.3, 4.4 Hz), 2.44 (3H,s), 3.39 (1H, t, J = 8.1Hz), 3.47 (1H, dd, J = 10.3, 5.9 Hz), 4.46-4.52(1H, m), 4.62-4.66 (2H, m), 5.22-5.38 (1H, m), 5.87-5.99 (1H, m).

60

MSスペクトル m/z: 186 (M+1)+

(3) 参考例19-(2)で得られた化合物(3.0g)をテトラヒドロフラン(60m1)に溶解し、氷10 冷下、トリエチルアミン(3.38g)及び塩化メタンスルホニル(1.91g)を順次加えた。反応液に酢酸エチル(500m1)を加えて抽出し、有機層を重曹水、飽和食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下濃縮した。得られた残渣をカラムクロマトグラフィー(シリカゲル 150g、ヘキサン:酢酸エチル=2:1-1:3)で精製し、無色油状物質として(2S,4R)-4-メタンスルホニルオキシー1-メチル-2-ビロリジンカルボン酸 アリル(3.33g)を得た。

20 【0222】赤外線吸収スペクトル (neat) ν max c m⁻¹ : 2946, 1743, 1357, 1174, 968,898.

核磁気共鳴スペクトル (400MHz, CDCl₃) δ ppm: 2.44-2.49 (2H, m), 2.51 (3H, s), 2.78 (1H, dd, J = 11.0, 4.4 Hz), 3.08 (3H, s), 3.47 (1H, t, J = 7.7 Hz), 3.62 (1H, dd, J = 11.0, 6.6 Hz), 4.46-4.72 (1H, m), 5.25-5.35 (1H, m), 5.28-5.42 (2H, m), 5.92-6.03 (1H, m).

MSスペクトル m/z: 264 (M+1)+

(4) 参考例19-(3)で得られた化合物(1.6 30 8 g)をジメチルアセトアミド(30 m1)に溶解し、炭酸セシウム(1.56 g)及びチオ酢酸(72 8 mg)を加え、70℃で2.5時間攪拌した。反応液に酢酸エチル(300 m1)を加え抽出し、有機層を重曹水、飽和食塩水で順次洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下濃縮した。得られた残渣をカラムクロマトグラフィー(シリカゲル 75g、ヘキサン:酢酸エチル=4:1-1:1)で精製し、無色油状物質として(2S,4S)-4-アセチルチオー1-メチル-2-ピロリジンカルボン酸 アリル(1.09 40 g)を得た。

【0223】赤外線吸収スペクトル (neat) レmax cm⁻¹: 2950, 2786, 1747, 1689, 1450,1270, 1183, 1138. 核磁気共鳴スペクトル (400MHz, CDCl₃) δppm: 1.95-2.06 (1H, m), 2.30 (3H, s), 2.43 (3H, s), 2.71 (1H, dt, J = 13.9, 8.8 Hz), 2.86 (1H, dd, J = 10.3, 6.6 Hz), 3.06-3.13 (2H, m), 3.95-4.02 (1H, m), 4.6 5-4.69 (2H, m), 5.23-5.38 (2H, m), 5.78-5.99 (1H, m).

MSスペクトル m/z: 204 (M+1)*

50 (5) 参考例19-(4)で得られた化合物(300

mg)を酢酸エチル(6 m1)に溶解し、トリフェニルホスフィン(71 mg)、ジメドン(191mg)及びテトラキストリフェニルホスフィンパラジム(71 mg)を加え、1.5時間投拌した。析出した粉末を沪取することにより、無色粉末として標記目的化合物(204 mg)を得た。スペクトルデータは参考例1ー(4)の化合物に一致した。

[0224]

【発明の効果】本発明の一般式(1)で表わされるメルカプトピロリンジン化合物及びその塩は、優れた抗菌活性を有するカルバペネム系抗菌剤の2位側鎖部分を構築する際、工業的に重要な製造中間体であり、既に公知である4-(4-メトキシベンジルチオ)ピロリジン化合物に比べて保護基の除去が容易であり有用性が高い。

62

フロントページの続き

(72)発明者 菅野 修

東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内

(72)発明者 小島 克彦

東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内

Fターム(参考) 40069 AA16 BC16 BD06